#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2004年12月2日(02.12.2004)

PCT

#### (10) 国際公開番号 WO 2004/104055 A1

(51) 国際特許分類7: 4/645, B65D 1/00, F16L 9/12 C08F 210/02,

PCT/JP2004/007124

(21) 国際出願番号: (22) 国際出願日:

2004年5月19日(19.05.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-141246

2003年5月20日(20.05.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三井化 学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒 105-7117 東京都港区 東新橋 1 丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松浦 貞彦 (MAT-SUURA,Sadahiko) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦 市 長浦 5 8 0-3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 松川 直人 (MATSUKAWA, Naoto) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦580-32 三井化学株式会 社内 Chiba (JP). 三谷 誠 (MITANI, Makoto) [JP/JP]; 〒 299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦580-32 三井化 学株式会社内 Chiba (JP). 斎藤 純治 (SAITO, Junji) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦 5 8 0 – 3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 藤田 照典 (FU-JITA,Terunori) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ヶ浦市 長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 土 肥靖 (TOHI,Yasushi) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉県 袖ケ 浦市 長浦 5 8 0-3 2 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 遠藤 浩司 (ENDO,Koji) [JP/JP]; 〒299-0265 千葉 県 袖ヶ浦市 長浦580−32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 岩政 健司 (IWAMASA, Kenji) [JP/JP]; 〒

「続葉有)

(54) Title: ETHYLENE POLYMER

(54) 発明の名称: エチレン系重合体

(57) Abstract: An ethylene/C<sub>3-10</sub> α-olefin copolymer which has (i) a melt flow rate MFR (190°C, 2.16 kg) of 0.01 to 10 g/10min, (ii) a melt tension MT satisfying MT≥3.2×MFR-0.55, (iii) a flow activation energy Ea satisfying Ea<30 KJ/mol, and (iv) a swelling index of 1.36 or higher. It is produced using a solid catalyst ingredient comprising (A) a transition metal compound mixture of (A1) a Group 4 transition metal compound having a salicylaldimine ligand and (A2) a Group 4 transition metal compound having a cyclopentadienyl ligand, (B) an organometallic compound ingredient, and (C) a support. The copolymer is suitable for blow molding and extrusion molding.

(57) 要約:

(i)メルトフローレートMFR (190℃, 2.16kg) 0.01~10g/10min

(ii) メルトテンションMT≥3.2×MFR<sup>-0.55</sup>

(iii) 流動活性化エネルギーEa<30KJ/mol

(iv) スウェル比≧1.36

であるエチレン・炭素数3~10のα-オレフィン共重合体。

これは、サリチルアルドイミン配位子を有する第4族遷移金属化合物

(A1) とシクロペンタジエニル配位子を有する第4族遷移金属化合物

(A2) との混合遷移金属化合物 (A)、有機金属化合物成分

(B)、担体(C)からなる固体状触媒成分を用いて製造され、プロ

- 成形、押出成形に好適である。

WO 2004/104055 A1

299-0108 千葉県 市原市 千種海岸 3 三井化学株式 会社内 Chiba (JP). 高橋 景子 (TAKAHASHI,Keiko) [JP/JP]; 〒299-0108 千葉県 市原市 千種海岸 3 三井化 学株式会社内 Chiba (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

# 明細書

# エチレン系重合体

#### 技術分野

5

10

20

25

本発明は新規なエチレン系重合体、このエチレン系重合体を製造するための重合用触媒と重合方法、および該エチレン系重合体の用途に関する。詳しくは、(1)特定の性質を満たすエチレン系重合体、(2)サリチルアルジミン配位子含有遷移金属化合物とシクロペンタジエニル配位子含有遷移金属化合物をそれぞれ少なくとも1種以上と、有機金属化合物、有機アルミニウムオキシ化合物、および遷移金属化合物と反応してイオン対を形成する化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物とが固体状担体に担持された重合用触媒、を用いた前記エチレン系重合体の製造方法、および(3)前記エチレン系重合体のブロー成形体やパイプ等への用途に関する。

## 15 背景技術

ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィンは、炭素と水素からなる環境にやさしいクリーンな材料であり加工成形性や物性に優れている。この特性から、自動車、電気機器部品、食品包装、飲料・化粧品・医療用容器、土木、農業資材等幅広い分野に用いられてきた。しかし近年においてはポリオレフィンに対する物性の要求が多様化しており、様々な特性を持つポリオレフィンが望まれている。また、生産性の更なる向上も望まれている。特に、中空成形やシート成型を行う場合、溶融張力(以下、メルトテンション(MT)と呼称する場合がある。)やスウェル比が高いことが求められる。

これらの物性が良好なエチレン系重合体として高圧法で製造されたポリエチレンや Cr 系フィリップス型触媒によって得られるポリエチレンが知られているが、長鎖分岐が多量に存在するため、剛性や衝撃強度が低下する。また長鎖分岐の量を制御することや αオレフィンコモノマーの導入は困難であり、達成可能な物性に限界があった。また、これらの高圧法ポリエチレンは成形時に樹脂流動化が起きるための温度依存性の尺度である流動活性化エネルギーが

高いという問題点があった。

10

15

20

25

従来からエチレン重合体、エチレン/ α-オレフィン共重合体等のエチレン系 重合体を製造するための重合触媒としては、チタン系化合物と有機アルミニウ ム化合物とからなるチーグラー型チタン系触媒が広く知られている。さらに近年 において、高い重合活性でオレフィン重合体を製造することのできる触媒とし てシクロペンタジエニル基を有 するメタロセン化 合物と有機アルミニウムオキシ 化合物 (アルミノキサン)とからなるメタロセン系触媒が知られるようになり、さら に最近では、ジイミン構造の配位子を持った遷移金属化合物からなる新規な 触媒系も提案(WO96/23010A2 参照)されるようになった。 本出願人らも最近、 新規なオレフィン重合触媒として、WO2004/ 029062A1 において組成分布が 狭いエチレン系 重合 体を製造 する触媒として好適なシクロペンタジエニル基を 有 するメタロセン化 合 物 を提 案 する 一 方 で、特 開 平 11-315109 号 公 報 や EP0874005A1 において、サリチルアルジミン配位子を有する遷移金属化合物 を提案している。このサリチルアルジミン配位子含有遷移金属化合物は、合成 が容易であり、かつ高いエチレン重合性能を有し、さらには配位子の構造変 換により分子量、共重合性等の重合性能の制御が可能であるという特徴を有 する。

. .

しかしこれらの重合触媒を用いて得られたエチレン系重合体は、前述の高 圧法ポリエチレンや Cr 系触媒品に比べ剛性や衝撃強度には優れるものの、 MT やスウェル比に関しては十分といえず、改良の余地があった。

上記の触媒系については、これらの問題点を改良するための提案がいくつかなされている。たとえば、特開平 7-278221 では特定の Ti 化合物、液状のMg化合物およびエーテル結合有する化合物の組合せによりMTおよびスウェル比に優れたエチレン系重合体が得られることが記載されている。ただしこの場合もスウェル比は 1.35 以下と十分高い値といえない。また本発明者らは特開 2002-105132 号公報に特定の遷移金属化合物の組合せにより長鎖分岐含有ポリオレフィンの製造法を開示している。しかし、この場合でも長鎖分岐の導入によって流動の活性化エネルギーは増大するものの、MT 向上への効果は低いものであった。

一方、ポリエチレン系重合体をはじめとするポリオレフィンの製造プロセスに目を転じれば、例えば高密度ポリエチレンは、従来チーグラー型触媒を用いる低圧法により一般的にはスラリー重合法により製造されてきた。このような高密度ポリエチレンのうち、成形性及び物性を制御する目的で任意の分子量分布を有する高密度ポリエチレンを製造する際には、重合を多段で行い、通常各段において生成する重合体の分子量及び密度を制御して重合が行われる。具体的には、低分子量ポリエチレン重合工程と高分子量ポリエチレン重合工程からなる多段スラリー重合工程から構成されるが、このような多段プロセスの場合は、工程が多段であるが故の操作の煩雑さや、低分子量ポリエチレン生成工程おいて大量の水素を使用しなければならない、といったプロセス及びコスト面で解決すべき点が残されている。

本発明者等は上記のような溶融張力の向上や多段重合法によるポリオレフィンのプロセス合理化について研究を行ったところ、特定のオレフィン重合用 触媒を用いて、長鎖分岐の長さや導入量を制御することにより、優れた溶融 張力を示し、かつ流動の活性化エネルギーが低いというこれまでの樹脂の欠 点を克服するポリオレフィンを見出したのである。

#### 発明の開示

10

15

20

25

本発明のエチレン系重合体は、エチレンと炭素数  $3\sim10$  の  $\alpha$ -オレフィンから得られる共重合体であって、下記要件(i)、(ii)、(iii) および(iv)を同時に満たすことを特徴としている。

- (i) 190℃における、2.16kg 荷重でのメルトフローレート[MFR₂(g/10min)]が0.01~10 の範囲にあること。
- (ii) メルトテンション[MT(g)]と前 記メルトフローレート[MFR<sub>2</sub>(g/10min)]が、 MT  $\geq 3.2 \times MFR_2^{-0.55}$

で表わされる関係式を満たすこと。

- (iii) 流動の活性化エネルギ-[Ea]が、30(KJ/mol)未満であること。
- (iv) スウェル比が 1.36 以上であること。 また本発明のエチレン系重合体は、

(A1)下記一般式[I]で表される第4族遷移金属化合物、

- (A2)下記一般式[Ⅱ]で表される第 4 族遷移金属化合物、並びに
- (B)(b-1) 有機金属化合物、
  - (b-2) 有機アルミニウムオキシ化合物、および
  - (b-3) 遷移金属化合物(A1)又は(A2)と反応してイオン対を形成する化合物、から選ばれる少なくとも1種の化合物が
- (C) 固体状担体に担持されている固体状触媒成分の存在下、エチレンと炭素数  $3\sim10$  の  $\alpha$ -オレフィンを共重合することにより好適に得られることを特徴としている。

10

5

15

[式[I]中の各種の符号の意味については、後述する「発明を実施するための最良の形態」において詳説する。〕

20

25

[式[II]中のの各種の符号の意味については、後述する「発明を実施するた

めの最良の形態」において詳説する。〕

さらに本発明は、前記のエチレン系重合体からなるブロー成形体に関する。 ブロー成形体の中でもドラム缶、大型コンテナー、大型ガソリンタンク、大型工業薬品缶または大型ボトル容器に好適に使用される。

また、本発明は前記のエチレン系重合体からなるパイプ又はパイプ継ぎ手に関する。

#### 図面の簡単な説明

第 1 図は、実施例と比較例で得られたエチレン系重合体の溶融張力 (MT) 10 と MFR<sub>2</sub> の値をプロットした図である。

### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明におけるエチレン系重合体およびその用途について具体的に説明する。

- 15 本発明のエチレン系重合体は、エチレンと炭素数  $3\sim10$  の  $\alpha$ -オレフィンから得られる共重合体であって、下記要件(i)、(ii)、(iii)および(iv)を同時に満たすことを特徴とする。
  - (i) 190℃における、2.16kg 荷重でのメルトフローレート[MFR2(g/10min)]が 0.01~10 の範囲にあること。
- 20 (ii) メルトテンション[MT(g)]と前 記メルトフローレート[MFR<sub>2</sub>(g/10min)]が、 下記不等式(Eq-1)を満たすこと。

 $MT \ge 3.2 \times MFR_2^{-0.55}$  -----(Eq-1)

- (iii) 流動の活性化エネルギ-[Ea]が、30(KJ/mol)未満であること。
- (iv) スウェル比が 1.36 以上であること
- 25 本発明のエチレン系重合体は、エチレン単独重合体またはエチレンと炭素数  $3\sim10$  の  $\alpha$ -オレフィンから得られる共重合体、すなわちエチレンに由来する構造単位を必須成分として含有し、更に炭素数  $3\sim10$  の  $\alpha$ -オレフィンに由来する構造単位をも含む。炭素数  $3\sim10$  の  $\alpha$ -オレフィンは一種類であってもよいし、異なる二種類以上であってもよい。ここで炭素原子数が  $3\sim10$  の  $\alpha$ -オレ

フィン(以下単に「 $\alpha$ -オレフィン」と略称する場合がある。)としては、例えば、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、3-メチル-1-ブテン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、3-メチル-1-ペンテン、1-オクテン、1-デセンなどが挙げられる。本発明においては、これらの $\alpha$ -オレフィンの中で、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、1-オクテンから選ばれる少なくても 1 種に由来する構成単位を含むことが好ましく、1-ヘキセンに由来する構成単位を含むことが特に好ましい。また本発明のエチレン系重合体中には、炭素原子数 3~10 の  $\alpha$ -オレフィンから導かれる構成単位を、通常 0~5.0mol%、好ましくは 0.05~1.0mol%、特に好ましくは、0.1~0.5mol%含むエチレン系重合体である。

本発明のエチレン系重合体は前記した要件(i)、(ii)、(iii)および(iv)を同時に満たすことを特徴とする。以下各要件について詳細に説明する。

#### 要件(i)

10

15

- 20

本発明のエチレン系重合体の、190℃における、2.16kg 荷重でのメルトフローレート[MFR<sub>2</sub>(g/10min)]が 0.01~10 の範囲にある。メルトフローレート [MFR<sub>2</sub>(g/10min)]の好ましい範囲は 0.01~5、更に好ましい範囲は 0.1~5 の 範囲にある。

# <u>要件(ii)</u>

本発明のエチレン系重合体は、前記の 2.16kg 荷重でのメルトフローレート  $[MFR_2(g/10min)]$  の範囲で、このメルトフローレート値とメルトテンション [MT(g)]が下記の不等式(Eq-1)を満たしていることに一つの特徴がある。好ましくは下記不等式(Eq-2)、特に好ましくは下記不等式(Eq-3)を満たす。

$$MT \ge 3.2 \times MFR_2^{-0.55}$$
 ----(Eq-1)  
 $12.0 \times MFR_2^{-0.55} \ge MT \ge 3.2 \times MFR_2^{-0.55}$  ----(Eq-2)  
 $8.0 \times MFR_2^{-0.55} \ge MT \ge 3.6 \times MFR_2^{-0.55}$  ----(Eq-3)

## 25 <u>要件(iii)</u>

本発明のエチレン系重合体の流動活性化エネルギ-[Ea]は、30(KJ/mol)未満、好ましくは  $10\sim28(KJ/mol)$ 、特に好ましくは  $20\sim28(KJ/mol)$ である。 Ea がこのような範囲にあると、流動性に優れる点で有利となる。

## <u>要件(iv)</u>

本発明のエチレン系重合体のスウェル比が1.36以上、好ましくは1.40以上である。スウェル比がこのような範囲にあると中空成形を行う際に肉厚分布が小さく均一なものが得られる。

本発明のエチレン系重合体は、前記要件(i)~(iv)に加えて下記要件(v)~(vii)をも満たしていることが好ましい。

## 要件(v)

本発明のエチレン系重合体の密度が、 $910\sim970(kg/m^3)$ 、好ましくは  $920\sim970(kg/m^3)$ 、より好ましくは  $930\sim970(kg/m^3)$ の範囲にある。

#### 要件(vi)

10 本発明のエチレン系重合体の極限粘度[ $\eta$ ]は、 $1.0\sim5.0(dl/g)$ 、好ましくは  $1.5\sim3.0(dl/g)$ の範囲にある。

## 要件(vii)

20

25

本発明のエチレン系重合体の極限粘度([η](dl/g))と、190℃、21.6kg 荷 重でのメルトフローレート[MFR<sub>20</sub>(g/10min)]が以下の不等式(Eq-4)を満たす。 また、好ましくは不等式(Eq-5)を満たす。

$$[\eta] \le -1.3\log(MFR_{20}) + 4.35$$
 ----(Eq-4)

 $-1.3\log(MFR_{20}) + 3.50 \le [\eta] \le -1.3\log(MFR_{20}) + 4.35 ----(Eq-5)$ 

なお、190℃、21.6kg 荷重でのメルトフローレート[MFR<sub>20</sub>(g/10min)]は通常、1~100(g/10min)、好ましくは 1~50(g/10min)、特に好ましくは、2~30(g/10min)の範囲にある。

上記要件(i)~(iv)を満たし、好ましくは前記要件(v)~(vii) が規定するパラメーター範囲を満足する本発明のエチレン系重合体は、後述する本願実施例の製造条件そのもの、あるいは条件因子のマイナー変動、あるいはこれら樹脂ブレンドによって任意に作り分けることが可能である。条件因子変動の具体例を述べると、用いる遷移金属化合物[I]、[II]の構造、担持する比率、用いる担体及び助触媒成分の種類など触媒成分に関する要件や重合温度、共存させる水素などの分子量調整剤の量、添加するコモノマー量など重合条件制御によって作り分けが可能である。またさらに多段重合との組合せで、物性の範囲を拡大することも可能である。

より具体的には、例えば重合温度を低下させること、コモノマー添加量を増加させること、用いる遷移金属化合物[I]の構造を変えること等によって、ポリマー中に導入できる長鎖分岐の量を増加させることが可能であり、この場合MFRの値に対するMTの値は高くなり、[n]の値は低くなる傾向がある。また流動の活性化エネルギー(Ea)は、遷移金属触媒の組合せを変えることによって制御可能である。特に[I]の構造を有する遷移金属化合物と配位子として2つのシクロペンタジエニル骨格を含有し、この2つのシクロペンタジエニル骨格同士が第14族原子を会して結合した第4族遷移金属化合物である場合にEaを30KJ/mol以下に抑制することが可能である。

10 本発明のエチレン系重合体は、

5

- (A1) 下記一般式[I]で表される第4族遷移金属化合物、
- (A2) 下記一般式[II]で表される第4族遷移金属化合物並びに 3
- (B)(b-1) 有機金属化合物、
  - :(b-2) 有機アルミニウムオキシ化合物、および
- 15 (b-3) 遷移金属化合物(A1)、(A2)と反応してイオン対を形成する化合物、から選ばれる少なくとも1種の化合物が
  - (C) 固体状担体に担持されている重合触媒の存在下、エチレンと、前述の炭素数 3~10 の α-オレフィンを共重合することにより好適に得られる。

以下、本発明に係わる、前記重合触媒の各構成成分ついて詳細に説明 20 する。

(A1)下記一般式[I]で表される第4族遷移金属化合物

(上記一般式[I]中、 $N\cdots$ Mは、一般的には配位していることを示すが、本

発明においては配位していてもしていなくてもよい。)

一般式[I]中、M は周期表第 4 族遷移金属原子を示し、具体的にはチタン、ジルコニウム、ハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。

m は、 $1\sim4$  の整数を示し、好ましくは 2 であ、n は、M の価数を満たす数であり、 $R^1\sim R^6$  は互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの 2 個以上が互いに連結して環を形成していてもよい。

10 また、mが2以上の場合にはR<sup>1</sup>~R<sup>6</sup>で示される基のうち2個の基が連結されていてもよく(但し、R<sup>1</sup>同士が結合されることはない)

X は、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、n が 2 以上の場合は、X で示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、また X で示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

以下、R1~R6を具体的に述べる。

15

ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。

20 炭化水素基として具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、 t-ブチル基、ネオペンチル基、n-ヘキシル基等の炭素原子数が 1~30、好ましくは 1~20 の直鎖状または分岐状のアルキル基;ビニル基、アリル(allyl)基、イソプロペニル基等の炭素原子数が 2~30、好ましくは 2~20 の直鎖状または分岐状のアルケニル 基;エチニル基、プロパルギル基等炭素原子数が 2~30、好ましくは 2~20 の直鎖状または分岐状のアルキニル基;シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基等の炭素原子数が 3~30、好ましくは 3~20 の環状飽和炭化水素基; シクロペンタジエニル基、インデニル基、フルオレニル基等の炭素数 5~30 の環状不飽和炭化水素基;フェニル

PCT/JP2004/007124 WO 2004/104055

基、ナフチル基、ビフェニル基、ターフェニル基、フェナントリル基、アントラセニ ル基等の炭素原子数が6~30、好ましくは6~20のアリール(aryl)基;トリル基、 iso-プロピルフェニル基、tert-プチルフェニル基、ジメチルフェニル基、ジ-tert-ブチルフェニル基等のアルキル置換アリール基等が挙げられる。

上記炭化水素基は、水素原子がハロゲンで置換されていてもよく、たとえば、 トリフルオロメチル基、ペンタフルオロフェニル基、クロロフェニル基等の炭素原 子数 1~30、好ましくは 1~20 のハロゲン化炭化水素基が挙げられる。

. 5

20

25

また、上記炭化水素基は、他の炭化水素基で置換されていてもよく、たとえ ば、ベンジル基、クミル基、2,2-ジフェニルエチル基、トリフェニルメチル基等の 10 アリール基置換アルキル基等が挙げられる。

さらにまた、上記炭化水素基は、ヘテロ環式化合物残基;アルコシキ基、ア リーロキシ(aryloxy)基、エステル基、エーテル基、アシル基、カルボキシル基、 カルボナート基、ヒドロキシ基、ペルオキシ基、カルボン酸無水物基等の酸素 含有基;アミノ基、イミノ基、アミド基、イミド基、ヒドラジノ基、ヒドラゾノ基、ニトロ 15 基、ニトロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアン酸エステル基、アミジノ基、ジア ・ゾ基、アミノ基がアンモニウム塩となったもの等の窒素含有基;ボランジイル基、 ボラントリイル基、ジボラニル基等のホウ素含有基;メルカプト基、チオエステル 基、ジチオエステル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、チオアシル基、チオ エーテル基、チオシアン酸エステル基、イソチアン酸エステル基、スルホンエス テル基、スルホンアミド基、チオカルボキシル基、ジチオカルボキシル基、スルホ 基、スルホニル基、スルフィニル基、スルフェニル基等のイオウ含有基:ホスフィ ド基、ホスホリル基、チオホスホリル基、ホスファト基等のリン含有基、ケイ素含 有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を有していてもよい。

これらのうち、特に、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ネオペンチル基、n-ヘキシル基等の炭素原子数 1~30、好ましくは 1~20 の直鎖状または分岐状 のアルキル基;フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、ターフェニル基、フェナ ントリル基、アントラセニル基等の炭素原子数 6~30、好ましくは 6~20 のアリ ール基:これらのアリール基にハロゲン原子、炭素原子数 1~30、好ましくは 1

~20 のアルキル基またはアルコキシ基、炭素原子数 6~30、好ましくは 6~20 のアリール基またはアリーロキシ基等の置換基が 1~5 個置換した置換アリー ル基等が好ましい。

酸素 含 有 基、窒 素 含 有 基、ホウ素 含 有 基、イオウ含 有 基、リン含 有 基とし ては、上記例示したものと同様のものが挙げられる。

- 5

15

25

ヘテロ環式化合物残基としては、ピロール、ピリジン、ピリミジン、キノリン、トリー アジン等の含窒素化合物、フラン、ピラン等の含酸素化合物、チオフェン等の 含硫黄化合物等の残基、およびこれらのヘテロ環式化合物残基に炭素原子 数が 1~30、好ましくは 1~20 のアルキル基、アルコキシ基等の置換基がさら、 10 に置換した基等が挙げられる。

ケイ素含有基としては、シリル基、シロキシ基、炭化水素置換シリル基、炭 化水素置換シロキシ基等、具体的には、メチルシリル基、ジメチルシリル基、ト リメチルシリル基、エチルシリル基、ジエチルシリル基、トリエチルシリル基、ジフニ ・ェニルメチルシリル基、トリフェニルシリル基、ジメチルフェニルシリル基、ジメチ ル-t-ブチルシリル基、ジメチル(ペンタフルオロフェニル)シリル基等が挙げられ る。これらの中では、メチルシリル基、ジメチルシリル基、トリメチルシリル基、エ チルシリル基、ジエチルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチルフェニルシリル 基、トリフェニルシリル基等が好ましい。特にトリメチルシリル基、トリエチルシリ ル基、トリフェニルシリル基、ジメチルフェニルシリル基が好ましい。 炭化水素置 20 換シロキシ基として具体的には、トリメチルシロキシ基等が挙げられる。

ゲルマニウム含有基およびスズ含有基としては、前記ケイ素含有基のケイ 素をゲルマニウムおよびスズに置換したものが挙げられる。

R1~R6は、これらのうちの2個以上の基、好ましくは隣接する基が互いに連 結して脂肪環、芳香環または、窒素原子等の異原子を含む炭化水素環を形 成していてもよく、これらの環はさらに置換基を有していてもよい。

また、m が 2 以上の場合には、R1~R6で示される基のうち 2 個の基が連結 されていてもよい。さらに、mが2以上の場合には $R^1$ 同士、 $R^2$ 同士、 $R^3$ 同士、 R4同士、R5同士、R6同士は、互いに同一でも異なっていてもよい。

n は、M の価数を満たす数であり、具体的には  $0\sim5$ 、好ましくは  $1\sim4$ 、より

好ましくは 1~3 の整数である。

X は、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、n が 2 以上の場合は、X で示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、また X で示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

以下、具体例を述べる。

5

15

20

ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。

10 炭化水素基としては、前記 R<sup>1</sup>~R<sup>6</sup> で例示したものと同様のものが挙げられる。これらのうち、炭素原子数が 1~20 のものが好ましい。

また、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、イオウ含有基および窒素含有基としては、前記 R<sup>1</sup>~R<sup>6</sup>で例示したものと同様のものが挙げられる。

ホウ素含有基として具体的には、BR<sub>4</sub>(R は水素、アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、ハロゲン原子等を示す)が挙げられる。

リン含有基として具体的には、トリメチルホスフィン基、トリブチルホスフィン基、トリシクロへキシルホスフィン基等のトリアルキルホスフィン基;トリフェニルホスフィン基、トリトリルホスフィン基等のトリアリールホスフィン基;メチルホスファイト基、エチルホスファイト基、フェニルホスファイト基等のホスファイト基(ホスフィド基);ホスホン酸基;ホスフィン酸基等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基およびスズ含有基として具体的には、 前記 R<sup>1</sup>~R<sup>6</sup>で例示したものと同様のものが挙げられる。

ハロゲン含有基として具体的には、PF<sub>6</sub>、BF<sub>4</sub>等のフッ素含有基、ClO<sub>4</sub>、 25 SbCl<sub>6</sub>等の塩素含有基、IO<sub>4</sub>等のヨウ素含有基が挙げられるが、これらに限定 されるものではない。

アルミニウム含有基として具体的には、AIR4(R は水素、アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、ハロゲン原子等を示す)が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

なお、nが2以上の場合は、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、また X で示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

本発明において、(A1)前記一般式[I]で表される第4族遷移金属化合物 5 として好ましい第4族遷移金属錯体は、下記一般式[III]で表される。

$$\mathbb{R}^{1'}$$
 $\mathbb{R}^{2}$ 
 $\mathbb{N}^{-}$ 
 $\mathbb{N}^{3}$ 
 $\mathbb{R}^{4}$ 
 $\mathbb{R}^{6}$ 
 $\mathbb{R}^{6}$ 
 $\mathbb{R}^{6}$ 
 $\mathbb{R}^{6}$ 

15

20

25

式中、Mは周期律表第4族遷移金属原子を示し、mは、1~4の整数を示し、R<sup>1</sup>は、下記一般式[IV]または[V]で表され、R<sup>2</sup>~R<sup>6</sup>は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよい。また、mが2の場合にはR<sup>2</sup>~R<sup>6</sup>で示される基のうち2個の基が連結されていてもよく(但し、R<sup>1</sup>同士が結合されることはない)。nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合は、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

(式中、 $R_a$  は水素原子、脂肪族炭化水素基または脂環族炭化水素基を示し、 $R_b$ 、 $R_c$  は水素原子あるいはメチル基を示し、互いに同一でも異なっていてもよい)

$$\begin{array}{c|c}
H & H \\
C_{\beta} & 5 \\
C_{\beta} & C_{\beta}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C_{\beta} & -----[V] \\
H & H
\end{array}$$

10

15

20

25

(式中、破線は2つの $C_\beta$ が直接結合するか、炭素数1以上の炭化水素基により、2つの $C_\beta$ と結合していることを示す)

R1'は、上記一般式[IV]または[V]で表わされる脂肪族炭化水素基あるいは 脂環族炭化水素基であり、たとえば炭素原子数が 1~30 のものが挙げられる。 具体的には、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、 sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチル、tert-アミル、1,2-ジメチルプロピル、イソ アミル、1-メチルブチル、2-メチルブチル、ネオペンチル、n-ヘキシル、1.3-ジメ チルブチル、3,3-ジメチルブチル、n-ヘプチル、1-メチルヘキシル、n-オクチル、 1.5-ジメチルヘキシル、2-エチルヘキシル、1-メチルヘプチル、n-ノニル、n-デ シル、n-ウンデシル、n-ドデシル、n-トリデシル、n-テトラデシル、n-ペンタデシ ル、n-ヘキサデシル、n-ヘプタデシル、n-オクタデシル、シクロプロピル、シクロ ブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、4-tert-ブチルシクロヘキシル、シクロ ヘプチル、シクロオクチル、シクロドデシル、アダマンチル、メチレンシクロプロピ ・ル、メチレンシクロブチル、メチレンシクロペンチル、メチレンシクロヘキシル、1-シクロヘキシルエチル等であり、これらの中で、R1'は、メチル、エチル、n-プロピ ル、n-ヘキシル、n-オクタデシル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチ ル、4-tert-プチルシクロヘキシル、メチレンシクロヘキシル、イソプロピル、1-メチ ルヘキシル、1,5-ジメチルヘキシル等が好ましく、4-tert-ブチルシクロヘキシル、 メチレンシクロヘキシル、イソプロピル、1-メチルヘキシル、1,5-ジメチルヘキシル が特に好ましい。

R2~R6 としては、前記一般式[I]で表わされる第 4 族遷移金属化合物に

PCT/JP2004/007124 WO 2004/104055

おいて説明した R2~R6を制限無く使用することができる。

5

また、m が2以上の場合には、R2~R6で示される基のうち2個の基が連結。 されていてもよい。さらに、mが2以上の場合にはR2同士、R3同士、R4同士、 R5同士、R6同士は、互いに同一でも異なっていてもよい。

Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、 窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有 基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ 含有基を示し、n が 2 以上の場合は、X で示される複数の基は互いに同一で も異なっていてもよく、また X で示される複数の基は互いに結合して環を形成 10 してもよい。

nは、Mの価数を満たす数であり、具体的には0~5、好ましくは1~4、より が 好ましくは 1~3 の整数である。

Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、 窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有 基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ 含有基を示し、具体的には前記一般式[1]で表わされる第 4 族遷移金属化 合物において説明した X を例示することができる。n が 2 以上の場合は、X で 示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、また X で示される複 数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

前記一般式[I]または[III]で表される第4族遷移金属化合物は、異なる二 20 **種以上の化合物を使用することもできる。** 

このような遷移金属化合物(A1)の製造方法は、特に限定されることなく、た とえば本出願人による特開平 11-315109 号公報や EP0874005A1 に記載方 法によって製造することができる。

以下に、上記一般式[Ⅲ]で表される第4族遷移金属化合物の具体的な例 25 を示すが、これらに限定されるものではない。

なお、上記例示中、Me はメチル基を、Et はエチル基を、tBu は tert-ブチル基を、Ph はフェニル基を示す。

本発明では、上記のような化合物において、ジルコニウム金属をチタン、ハフニウム等のジルコニウム以外の金属に置き換えた遷移金属化合物を用いることもできる。

## (A2) 一般式[II]で表される第 4 族遷移金属化合物

本発明に係わる、一般式[II]で表される第 4 族遷移金属化合物は下記のような架橋性メタロセン化合物である。

20

25

(式中、 $R^7 \sim R^{20}$  は水素、炭化水素基、ケイ素含有基から選ばれ、それぞれ同一でも異なっていてもよく、 $R^7 \sim R^{20}$  までの隣接した置換基は互いに結合して環を形成してもよく、M は第 4 族遷移金属原子であり、Y は第 14 族原子であり、Q はハロゲン、炭化水素基、アニオン配位子または孤立電子対で配位可能な中性配位子から同一または異なる組合せで選んでもよく、f は f の整数である。)

具体的には、R7~R<sup>20</sup>の炭化水素基としては、炭素数 1 から 20 のアルキル 基、炭素原子数 7~20 のアルキル基、炭素原子数 6~20 のアリール基等が挙 げられる。例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、アリール(allyl)基、n-ブチル基、tert-ブチル基、アミル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ペプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デカニル基、3-メチルペンチル基、1,1-ジエチルプロピル基、1,1-ジメチルプチル基、1-メチル-1-プロピルブチル基、1,1-プロピルブチル基、1,1-ジメチル-2-メチルプロピル基、1-メチル

-1-イソプロピル-2-メチルプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基、フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、フェナントリル基、アントラセニル基、ベンジル基、クミル基、メトキシ基、エトキシ基、フェノキシ基、N-メチルアミノ基、N,N-ジメチルアミノ基、N-フェニルアミノ基等が挙げられる。

ケイ素含有基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ジフェニルメ チルシリル基、ジメチルフェニルシリル基等を挙げることができる。

また、R<sup>19</sup>、R<sup>20</sup> が互いに結合して環を形成したシクロヘキシル基、シクロペンチル基、アダマンチル基等も挙げられる。

更に、R19、R20 の好ましい形態として挙げられるのが、R19、R20 のうち少なく 1Ó とも1つは無置換アリール基または置換アリール基である。この場合、いずれも 無置換アリール基または置換アリール基である時は R19と R20 が同一でも異な っていてもよい。更に具体的に述べると、R19、R20 が無置換アリール基あるい は置換アリール基で場合には、フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、ターフ ェニル基、フェナントリル基、アントラセニル基等の炭素原子数が 6~30、好ま 15 しくは 6~20 のアリール基、あるいはトリル基、iso-プロピルフェニル基、tert-ブ チルフェニル基、エチルフェニル基、ジメチルフェニル基、ジ-tert-ブチルフェニ ル基等のアルキル置換アリール基等が挙げられる。また、これらのアリール基に ハロゲン原子、炭素原子数 1~30、好ましくは 1~20 のアルキル基またはアル コキシ基、炭素原子数 6~30、好ましくは 6~20 のアリール基またはアリーロキ 20 シ基等の置換基が 1~5 個置換した置換アリール基等や、クロロフェニル基や ジクロロフェニル基、フルオロフェニル基、ジフルオロフェニル基、トリフルオロメ チルフェニル基、ジ(トリフルオロメチル)フェニル基等のハロゲン含有炭化水・ 素基等も挙げられる。

シクロペンタジエニル配位子とフルオレニル配位子を結ぶ共有結合原子Y は第 14 族原子であり、炭素原子、ケイ素原子、ゲルマニウム原子であり、アル キレン基、置換アルキレン基、シリレン基、置換シリレン基等である。具体的に は、例えば-C(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>-、-C(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>) (p-CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-、-C(p-CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>) (p-C H<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-、-C(tert-BuC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>) (tert-BuC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-、-SiC(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>-、-Si(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)

25

(p-CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-、-Si(p-CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)(p-CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-、-Si(tert-BuC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>) (tert-BuC<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-等の炭素数が 6~20 の不飽和炭化水素基等から成る架橋部が挙げられる。

Q はハロゲン、炭化水素基、アニオン配位子または孤立電子対で配位可能な中性配位子から同一または異なる組合せで選ばれる。jは1~4の整数であり、jが2以上の時は、Qは互いに同一でも異なっていてもよい。

ハロゲンの具体例としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素であり、炭化水素基の具体例としては前記と同様のものが挙げられる。

アニオン配位子の具体例としては、メトキシ、tert-ブトキシ、フェノキシ等のア 10 ルコキシ基、アセテート、ベンゾエート等のカルボキシレート基、メシレート、トシ レート等のスルフォネート基が挙げられる。

孤立電子対で配位可能な中性配位子の具体例としては、トリメチルホスフィン、トリエチルホスフィン、トリフェニルホスフィン、ジフェニルメチルホスフィン等の有機リン化合物、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン、1,2-ジメトキシエタン等のエーテル類が挙げられる。Q は、少なくても一つがハロゲンまたはアルキル基であることが好ましい。

**15**·

20

25

以下に、上記一般式[II]で表される第4族遷移金属化合物の具体的な例を示すが、これらに限定されるものではない。

ジ(m-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリフルオロメチル-フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリフルオロメチル-フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリフルオロメチル-フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンプフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリフルオロメチル-フェニル)メチレン(シクロペンタジエニカムジクロリド、ジ(m-トリフルオロメチル-フェニル)メチレン(シクロペンタジエニカムジクロリド、ジ(m-トリフルオロメチル-フェニル)メチレン(シクロペンタジエニ

ル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-トリフルオロメチル-フェニル)メ チレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウム ジクロリド、ジ(p-トリフルオロメチル-フェニル)メチレン(シクロペンタジエニ ル)(3,6-ジ tertープチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-トリフルオ ロメチル-フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベ 5 ンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-トリフルオロメチル-フェニル)メ チレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-トリ ル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジメチルフルオレニル)ジルコニウムジ クロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブチルフル オレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-イソプロピルフェニル)メチレン(シクロペ ンタジエニル)(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレ ニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-tertープチルフェニル)メチレン(シクロペンタ ジエニル)(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニ ル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(シクロペ 15 ンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジメ チル、シクロペンチリデン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ tert-ブチルフルオレ ニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘキシリデン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ・ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、アダマンチリデン(シクロペン タジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロ ペンチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ tert-ブチルフルオレニル)ジルコ ニウムジクロリド、シクロヘキシリデン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブチ ルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、アダマンチリデン(シクロペンタジエニ ル)(3,6-ジ tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロプロピリデ ン (シクロペンタジエニル)(3,6ージメチルーフルオレニル)ジルコニウムジクロリ 25 ド、シクロプチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジメチルーフルオレニル)ジル コニウムジクロリド、シクロペンチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6ージメチルー フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘキシリデン(シクロペンタジエニ ル)(3,6ージメチルーフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘプチリデン (シクロペンタジエニル)(3,6ージメチルーフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、

シクロプロピリデン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ tert-フルオレニル)ジルコニ ウムジクロリド、シクロブチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ tert-フルオレ ニル)ジルコニウムジクロリド、シクロペンチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘキシリデン(シクロペンタジ エニル)(3,6-ジ tertーフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘプチリデン 5 (シクロペンタジエニル)(3,6-ジ tert-フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シ クロプロピリデン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジクミルーフルオレニル)ジルコニ ウムジクロリド、シクロブチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6ージクミルーフルオ レニル)ジルコニウムジクロリド、シクロペンチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジクミルーフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘキシリデン(シクロペンタ 10 ジエニル)(3,6-ジクミルーフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘプチリ デン(シクロペンタジエニル)(3,6ージクミルーフルオレニル)ジルコニウムジクロリ ド、シクロプロピリデン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ tert-フルオレニル)ジル コニウムジブロミド、シクロブチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーフル オレニル)ジルコニウムジブロミド、シクロペンチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6 15 ージ tertーフルオレニル)ジルコニウムジブロミド、シクロヘキシリデン(シクロペン タジエニル)(3,6-ジtert-フルオレニル)ジルコニウムジブロミド、シクロヘプチリ デン (シクロペンタジエニル)(3,6-ジ tert-フルオレニル)ジルコニウムジブロミ ド、シクロプロピリデン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ tert-フルオレニル)ジル 20 コニウムジクロリド、シクロブチリデン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーフル オレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロペンチリデン(シクロペンタジエニル)(2,7 ージ tertーフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘキシリデン(シクロペン タジエニル)(2,7-ジ tert-フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘプチリ デン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、 シクロプロピリデン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフル 25 オレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロブチリデン(シクロペンタジエニル)(オクタ メチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロペンチリ デン (シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジ ルコニウムジクロリド、シクロヘキシリデン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオ

クタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘプチリデン(シク ロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベングフルオレニル)ジルコニウム ジクロリド、シクロプロピリデン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジ ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジブロミド、シクロブチリデン(シクロペンタジエ ニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジブロミド、シ 5 クロペンチリデン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオ レニル)ジルコニウムジブロミド、シクロヘキシリデン(シクロペンタジエニル)(オク タメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジブロミド、シクロヘプチ リデン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジ ルコニウムジブロミド、シクロプロピリデン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオ 10 クタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジメチル、シクロブチリデン(シクロ ペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジ メチル、シクロペンチリデン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベ ンゾフルオレニル)ジルコニウムジメチル、シクロヘキシリデン(シクロペンタジエニ・ ル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジメチル、シクロ 15 ヘプチリデン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレ ニル)ジルコニウムジメチル、ジn-ブチルメチレン(シクロペンタジエニル)(フルオ レニル)ジルコニウムジクロリド、ジn-ブチルメチレン(シクロペンタジエニル)(2,7 ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジn-ブチルメチレン(シ クロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、 20 ジn-ブチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフ ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジn-プチルメチレン(シクロペンタジエニ ル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジn-ブチルメチレン(シクロペン・ タジエニル)(ジベンプフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジn-プチルメチレン (シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリ 25 ド、ジn-ブチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルテトラヒドロジシクロ ペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジイソブチルメチレン(シクロペンタ ジエニル)(2,7-ジ tert-プチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジイソプ チルメチレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertープチルフルオレニル)ジルコ

ニウムジクロリド、ジイソブチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオク タヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジイソブチルメチレン(シク ロペンタジエニル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジイソブチルメ チレン(シクロペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ 5 イソブチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジ ルコニウムジクロリド、ジイソブチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチル テトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジベンジルメチ レン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジ クロリド、ジベンジルメチレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブチルフル オレニル)ジルコニウムジクロリド、ジベンジルメチレン(シクロペンタジエニル)(オ クタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジベンジル メチレン(シクロペンタジエニル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ ベンジルメチレン(シクロペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジ クロリド、ジベンジルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベングフルオ レニル)ジルコニウムジクロリド、ジベンジルメチレン(シクロペンタジエニル)(オク 15 タメチルテトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジフェネ チルメチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコ ニウムジクロリド、ジフェネチルメチレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブ チルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジフェネチルメチレン(シクロペンタジ エニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、 20 ジフェネチルメチレン(シクロペンタジエニル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウム ジクロリド、ジフェネチルメチレン(シクロペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジフェネチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒド ロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジフェネチルメチレン(シクロペ ンタジエニル)(オクタメチルテトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウム 25 ジクロリド、ジ(ベンズヒドリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブ チルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ベンズヒドリル)メチレン(シクロペ ンタジエニル)(3,6ージtertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ベ ンズヒドリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフ

ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ベンズヒドリル)メチレン(シクロペンタジ エニル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ベンズヒドリル)メチレン (シクロペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ベン ズヒドリル) メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジ ・ルコニウムジクロリド、ジ(ベンズヒドリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメ チルテトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(クミル)メ チレン (シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(クミル) メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウ ムジクロリド、ジ(クミル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブチルフ ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(クミル)メチレン(シクロペンタジエニ 10 ル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ク ミル)メチレン(シクロペンタジエニル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、 ジ(クミル)メチレン(シクロペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウム ジクロリド、ジ(クミル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンゾフル オレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(クミル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オ 15 クタメチルテトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(1 ーフェニルーエチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフル オレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(1-フェニルーエチル)メチレン(シクロペン タジエニル)(3,6-ジ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(1-フェニルーエチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベ 20 ンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(1-フェニルーエチル)メチレン(シ クロペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(1ーフェ ニルーエチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンゾフルオレニ ル)ジルコニウムジクロリド、ジ(1ーフェニルーエチル)メチレン(シクロペンタジエ ニル)(オクタメチルテトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリ 25 ド、ジ(シクロヘキシルメチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオク タヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(シクロヘキシルメチル) メチレン(シクロペンタジエニル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ (1-シクロヘキシルーエチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベ

ンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(シクロペンチルメチル)メチレン(シ クロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベングフルオレニル)ジルコニウ ムジクロリド、ジ(シクロペンチルメチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(ベンゾフ ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(シクロペンチルメチル)メチレン(シクロペ ンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(シクロペンチル 5 メチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジル コニウムジクロリド、ジ(シクロペンチルメチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オ・ クタメチルテトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ナ フチルメチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニ ル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ナフチルメチル)メチレン(シクロペンタジエニ 10 ル)(3,6-ジtert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ナフチルメチ ル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニ ル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ナフチルメチル)メチレン(シクロペンタジエニ ル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ナフチルメチル)メチレン(シ クロペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ナフチル 15 メチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジル コニウムジクロリド、ジ(ナフチルメチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメ チルテトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ビフェニ ルメチル)メチレン (シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、 ジ(ビフェニルメチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ。tertープチルフル 20 オレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ビフェニルメチル)メチレン(シクロペンタジ エニル)(3,6-ジ tert-プチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ビフェニ ルメチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフル オレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ビフェニルメチル)メチレン(シクロペンタジ エニル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ビフェニルメチル)メチ 25 レン(シクロペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ (ビフェニルメチル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンプフルオ レニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(ビフェニルメチル)メチレン(シクロペンタジエ ニル)(オクタメチルテトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリ

ド、ジメチルメチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ tert-ブチルフルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオ クタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルメチレン(シクロ ペンタジエニル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルメチレン (シクロペンタジエニル)(ジベングフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチル メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンプフルオレニル)ジルコニウム ジクロリド、ジメチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルテトラヒドロジシ クロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン(シクロペンタジ エニル)(2,7-ジ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルシ リレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウム 10 ジクロリド、ジメチルシリレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベ ンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン(シクロペンタジエニ ル)(ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン(シクロペンタ ジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン(シク ロペンタジエニル)(オクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ 15 メチルシリレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルテトラヒドロジシクロペンタフ ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロペンチリデン(シクロペンタジエニ ル)(2.7-ジ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘキシリ デン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertープチルフルオレニル)ジルコニウムジ 20 クロリド、アダマンチリデン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ tertーブチルフルオ レニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルメチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン(シクロペ ンタジエニル)(2,7-ジ tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p: ートリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブチルフルオレニル)ジ ルコニウムジクロリド、ジエチルメチレン(シクロペンタジエニル)(2,7ージ tertーブ 25 チルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロペンチリデン(シクロペンタジエ ニル)(3,6-ジ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、シクロヘキシリ デン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertープチルフルオレニル)ジルコニウムジ クロリド、アダマンチリデン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ tertーブチルフルオ

レニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチルメチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ tertーブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン(シクロペ ンタジエニル)(3,6-ジ tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p ートリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブチルフルオレニル)ジ ルコニウムジクロリド、ジエチルメチレン(シクロペンタジエニル)(3,6ージ tertーブ 5 チルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、モノフェニルモノメチルメチレン(シク ロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ フェニルメチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジル コニウムジクロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブ 10 チルフルオレニル)ジルロニウムジクロリド、モノフェニルモノメチルメチレン(シク ・ ロペンタジエニル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ フェニルメチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジル コニウムジクロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ-tert-ブ チルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、モノフェニルモノメチルメチレン(シク 15 ロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ハフニウムジクロリド、ジフ ェニルメチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル) ハフニ ウムジクロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチル フルオレニル) ハフニウムジクロリド、モノフェニルモノメチルメチレン(シクロペン タジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)チタニウムジクロリド、ジフェニルメ チレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)チタニウムジク 20 ロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレ ニル)チタニウムジクロリド、モノフェニルモノメチルメチレン(シクロペンタジエニ ル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジフ ェニルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンプフルオレ ニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタ 25 メチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、モノフェニルモ ノメチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルテトラヒドロジシクロペンタフ ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン(シクロペンタジエニ ル)(オクタメチルテトラヒドロジシクロペンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、

ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルテトラヒドロジシクロペ ンタフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、モノフェニルモノメチルメチレン(シクロ ペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチ レン(シクロペンタジエニル)(ジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ (p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(ジベンプフルオレニル)ジルコニウム ジクロリド、モノフェニルモノメチルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチル オクタヒドロジベンゾフルオレニル)ハフニウムジクロリド、ジフェニルメチレン(シク ロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ハフニウムジ クロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジ ベンゾフルオレニル)ハフニウムジクロリド、モノフェニルモノメチルメチレン(シク ロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)チタニウムジ クロリド、ジフェニルメチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベ ンプフルオレニル) チタニウムジクロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエ ニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)チタニウムジクロリド、ジ (p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、 ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジメチルフルオレニル)ジルコ ニウムジクロリド、ジ(p-tert-ブチルフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フ ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-tert-ブチルフェニル)メチレン(シクロ ペンタジエニル)(2,7-ジ-t-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ (p-tert-ブチルフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジメチルフルオレ ニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-tert-ブチルフェニル)メチレン(シクロペンタ ジエニル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-n-ブ チルフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロ リド、ジ(p-n-ブチルフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチ ルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-n-ブチルフェニル)メチレン(シク ロペンタジエニル)(2,7-ジメチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-n-ブチルフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニ ル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオ レニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリル)メチレン(シクロペンタジエニ

1.0

15

20

25

ル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(m-トリル)メチ レン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジメチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、 ジ(m-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニル) ジルコニウムジクロリド、(p-トリル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フ ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-イソプロピルフェニル)メチレン(シクロ 5 ペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-tert-ブチルフェニ ル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジメチル、 (p-トリル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジ ベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-イソプロピルフェニル)メチレン 10 (シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニ ウムジクロリド、ジ(p-tert-ブチルフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタ メチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-トリル)メチ レン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオクタヒドロジベンゾフルオレニル)ジル コニウムジメチル、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(オクタメチルオク 15 タヒドロジベンゾフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、(p-トリル)(フェニル)メチレ ン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリ ド、ジ(p-イソプロピルフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチ ルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-tert-ブチルフェニル)メチレン(シク ロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ 20 (p-トリル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジル コニウムジメチル、(p-トリル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ -tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-イソプロピルフェニル)メ チレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジ クロリド、ジ(p-tert-ブチルフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ 25 -tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(p-トリル)メチレン(シクロペ ンタジエニル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジメチル、(p-tert-プチルフェニル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコ ニウムジクロリド、(p-tert-ブチルフェニル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエ

ニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、(p-tert-ブチル フェニル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジメチルフルオレニル) 'ジルコニウムジクロリド、(p-tert-ブチルフェニル)(フェニル)メチレン(シクロペン タジエニル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、(p-n-エチ ルフェニル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウ ムジクロリド、(p-n-エチルフェニル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニ ル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、(p-n-エチルフェニ ル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジメチルフルオレニル)ジルコ ニウムジクロリド、(p-n-エチルフェニル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニ ・ル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、(4-ビフェニル)(フ ェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、 (4-ビフェニル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジ-tert-ブチルフ ルオレニル)ジルコニウムジクロリド、(4-ビフェニル)(フェニル)メチレン(シクロペ ンタジエニル)(2,7-ジメチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、(4-ビフェニ ル)(フェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ-tert-ブチルフルオレニル) 15 ジルコニウムジクロリド、ジ(4-ビフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(フルオ **'レニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(4-ビフェニル)メチレン(シクロペンタジエニ** ル)(2,7-ジ-tert-ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジ(4-ビフェニル)メ チレン(シクロペンタジエニル)(2,7-ジメチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、 ・ジ(4-ビフェニル)メチレン(シクロペンタジエニル)(3,6-ジ-t-ブチルフルオレニル) ジルコニウムジクロリド、または上記記載化合物の「シクロペンタジエニル」を 「(3-tert-ブチル-5-メチル-シクロペンタジエニル)」や「(3,5-ジメチル-シクロペン・ タジエニル)」等変えた化合物、ジルコニウムをハフニウム、チタニウム等に変え た化合物なども同様に挙げられる。

25 ただし、本発明の架橋メタロセン化合物は、上記の例示化合物に何ら限定されるものではなく、一般式[II]の要件を満たす全ての化合物を包含するものである。

本発明の上記一般式[II]で表される架橋性メタロセン化合物は公知の方法によって製造可能であり、特に製造法が限定されるわけではない。公知の

PCT/JP2004/007124 WO 2004/104055

製造方法として例えば、本出願人によるWO01/27174号公報が挙げられる。 また、本発明においては前記一般式[II]で表わされる第 4 族遷移金属化 合物以外に、配位子としてシクロペンタジエニル骨格を含有する第 4 族遷移 金属化合物 (A2')を用いて本発明のエチレン系重合体を製造することも可能・・・ である。このような第 4 族遷移金属化合物(A2')としては特に制限はないが、 好ましく使用されるメタロセン化合物としては、例えばビス(メチルシクロペンタ ジェニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(ジメチルシクロペンタジエニル)ジルコニ 。ウムジクロリド、ビス(ジメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムエトキシクロリド、 ビス(ジメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムビス(トリフルオロメタンスルホ ナト)、ビス(エチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(プロチル 10 シクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(メチルプロピルシクロペンタ ジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(ブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウ ムジクロリド、ビス(メチルブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビ ス(メチルブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムビス(トリフルオロメタンスル ホナト)、ビス(トリメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(テト 15 ラメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(ペンタメチルシクロ ペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(ヘキシルシクロペンタジエニル)ジ ルコニウムジクロリド、ビス(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジ クロリドなどが挙げられる。

- 5

20

25

上記のようなメタロセン化合物 (A2')の中でも、配位子として 2 つのシクロペー ンタジエニル骨格を含有し、この2つのシクロペンタジエニル骨格同士が第14 族原子を会して結合した第 4 族遷移金属化合物であることが好ましく、C2 対 称を有するキラルな構造のメタロセン化合物 (A2")を使用することがより好まし い。C2 対称を有するキラルな構造のメタロセン化合物(A2")としては、rac-エ チレン-ビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド、rac-エチレン-ビス(テトラヒドロ インデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス(2,3,5-トリメチル・ シクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス[1-(4-フェニルインデニル)]ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス[1-(2-メ チル-4-フェニルインデニル)]ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス

{1-[2-メチル-4-(1-ナフチル)インデニル]}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス{1-[2-メチル-4-(2-ナフチル)インデニル]}ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス{1-[2-メチル-4-(1-アントリル)インデニル]}ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス{1-[2-メチル-4-(9-アントリル)インデ ニル]}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス{1-[2-メチル-4-(9-フ ェナントリル)インデニル]}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス{1-[2-メチル-4-(o-クロロフェニル)インデニル]}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス{1-[2-メチル-4-(ペンタフルオロフェニル)インデニル]}ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス[1-(2-エチル-4-フェニルインデニル)] ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリル-ビス{1-[2-エチル-4-(1-ナフチル) · 10 インデニル]}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス{1-[2-エチル-4-(9-フェナントリル)インデニル]}ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビ ス[1-(2-n-プロピル-4-フェニルインデニル)]ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス{1-[2-n-プロピル-4-(1-ナフチル)インデニル]}ジルコニウムジ 15 クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス{1-[2-n-プロピル-4-(9-フェナントリル)イン デニル]}ジルコニウムジクロリドなどを好ましい例として挙げられる。

上記した第 4 族遷移金属化合物(A2)、(A2')は、異なる二種以上の化合物を使用することもできる。

本発明に係わる重合用触媒において、(A1)前記一般式[I]で表わされる 第 4 族遷移金属化合物、(A2)前記一般式[II]で表わされる第 4 族遷移金属化合物とともに用いられる、(b-1) 有機金属化合物、(b-2) 有機アルミニウムオキシ化合物、および(b-3) 遷移金属化合物(A1)、(A2)と反応してイオン対を形成する化合物から選ばれる少なくとも 1 種の化合物については、本出願人による特開平 11-315109 号公報や EP0874005A1 中に開示された化合物を制限無く使用することができる。

(b-1) 有機金属化合物としては、有機アルミニウム化合物が好ましく、1 種単独または 2 種以上を組み合わせて用いられる。(b-2) 有機アルミニウムオキシ化合物としては、トリアルキルアルミニウム、トリシクロアルキルアルミニウムから調製されたアルミノキサンが好ましく、トリメチルアルミニウムまたはトリイソブチル

アルミニウムから調製された有機アルミニウムオキシ化合物が特に好ましい。このような有機アルミニウムオキシ化合物は、1種単独または2種以上を組み合わせて用いられる。(b-3)遷移金属化合物(A1)、(A2)と反応してイオン対を形成する化合物としては、特開平1-501950号公報、特開平1-502036号公報、特開平3-179005号公報、特開平3-179006号公報、特開平3-207703号公報、特開平3-207704号公報、US5321106号などに記載されたルイス酸、イオン性化合物、ボラン化合物およびカルボラン化合物や、さらにはヘテロポリ化合物およびイソポリ化合物を制限無く使用することができる。

本発明に係る遷移金属化合物を触媒とする場合、助触媒成分としてのメチルアルミノキサン等の有機アルミニウムオキシ化合物 (b-2)とを併用すると、オレフィン化合物に対して非常に高い重合活性を示す。また助触媒成分としてトリフェニルカルボニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート等のイオン化イオン性化合物 (b-3)を用いると良好な活性で非常に分子量の高いオレフィン重合体が得られる。

15 また、本発明に係るオレフィン重合用触媒は、上記第4族遷移金属化合物 (A1)及び(A2)と、(b-1)有機金属化合物、(b-2)有機アルミニウムオキシ化合物、および(b-3)遷移金属化合物(A1)及び遷移金属化合物(A2)と反応してイオン対を形成する化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物(B)が、後述するような固体状担体(C)に担持されて用いられる。

### 20 (C)固体状担体

10

25

本発明で用いられる(C)固体状担体は、無機または有機の化合物であって、顆粒状ないしは微粒子状の固体である。

このうち無機化合物としては、多孔質酸化物、無機塩化物、粘土、粘土鉱物またはイオン交換性層状化合物が好ましい。

多孔質酸化物として、具体的には SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、MgO、ZrO、TiO<sub>2</sub>、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaO、ZnO、BaO、ThO<sub>2</sub>等、またはこれらを含む複合物または混合物を使用、例えば天然または合成ゼオライト、SiO<sub>2</sub>-MgO、SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub>、SiO<sub>2</sub>-V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、SiO<sub>2</sub>-Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub>-MgO 等を使用することができる。これらのうち、SiO<sub>2</sub>および/または Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を主成分とするものが好ましい。

なお、上記無機酸化物は、少量の Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、CaCO<sub>3</sub>、MgCO<sub>3</sub>、 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>、BaSO<sub>4</sub>、KNO<sub>3</sub>、Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>、Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>、Na<sub>2</sub>O、K<sub>2</sub>O、 Li<sub>2</sub>O 等の炭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、酸化物成分を含有していても差し支な い。

このような多孔質酸化物は、種類および製法によりその性状は異なるが、本発明に好ましく用いられる担体は、粒径が  $0.2\sim300\mu m$ 、好ましくは  $1\sim200\mu m$  であって、比表面積が  $50\sim1200m^2/g$ 、好ましくは  $100\sim1000m^2/g$  の範囲にあり、細孔容積が  $0.3\sim30cm^3/g$  の範囲にあることが望ましい。このような担体は、必要に応じて  $100\sim1000$  、好ましくは  $150\sim700$  で焼成して使用される。

5

10

無機塩化物としては、MgCl<sub>2</sub>、MgBr<sub>2</sub>、MnCl<sub>2</sub>、MnBr<sub>2</sub>等が用いられる。無機塩化物は、そのまま用いてもよいし、ボールミル、振動ミルにより粉砕した後に用いてもよい。また、アルコール等の溶媒に無機塩化物を溶解させた後、析出剤によってを微粒子状に析出させたものを用いることもできる。

15 本発明で用いられる粘土は、通常粘土鉱物を主成分として構成される。また、本発明で用いられるイオン交換性層状化合物は、イオン結合等によって構成される面が互いに弱い結合力で平行に積み重なった結晶構造を有する化合物であり、含有するイオンが交換可能なものである。大部分の粘土鉱物はイオン交換性層状化合物である。また、これらの粘土、粘土鉱物、イオン交換性層状化合物としては、天然産のものに限らず、人工合成物を使用することもできる。

また、粘土、粘土鉱物またはイオン交換性層状化合物として、粘土、粘土鉱物、また、六方細密パッキング型、アンチモン型、CdCl2型、CdI2型等の層状の結晶構造を有するイオン結晶性化合物等を例示することができる。

25 このような粘土、粘土鉱物としては、カオリン、ベントナイト、木節粘土、ガイロメ粘土、アロフェン、ヒシンゲル石、パイロフィライト、ウンモ群、モンモリロナイト群、バーミキュライト、リョクデイ石群、パリゴルスカイト、カオリナイト、ナクライト、ディッカイト、ハロイサイト等が挙げられ、イオン交換性層状化合物としては、α-Zr(HAsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>・H<sub>2</sub>O、α-Zr(HPO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>、α-Zr(KPO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>・3H<sub>2</sub>O、α-Ti(HPO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>、

PCT/JP2004/007124 WO 2004/104055

 $\alpha$ -Ti(HAsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O、 $\alpha$ -Sn(HPO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O、 $\gamma$ -Zr(HPO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>、 $\gamma$ -Ti(HPO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>、 y-Ti(NH<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O 等の多価金属の結晶性酸性塩等が挙げられる。

このような粘土、粘土鉱物またはイオン交換性層状化合物は、水銀圧入法 で測定した半径 20Å以上の細孔容積が 0.1cc/g 以上のものが好ましく、0.3 ~5cc/g のものが特に好ましい。ここで、細孔容積は、水銀ポロシメーターを用 いた水銀圧入法により、細孔半径 20~3×10<sup>4</sup> Åの範囲について測定される。

半径 20A以上の細孔容積が 0.1cc/g より小さいものを担体として用いた場 合には、高い重合活性が得られにくい傾向がある。

10

20

本発明で用いられる粘土、粘土鉱物には、化学処理を施すことも好ましい。 化学処理としては、表面に付着している不純物を除去する表面処理、粘土の 結晶構造に影響を与える処理等、何れも使用できる。化学処理として具体的 には、酸処理、アルカリ処理、塩類処理、有機物処理等が挙げられる。酸処 理は、表面の不純物を取り除くほか、結晶構造中のAl、Fe、Mg等の陽イオン を溶出させることによって表面積を増大させる。アルカリ処理では粘土の結晶 15 構造が破壊され、粘土の構造の変化をもたらす。また、塩類処理、有機物処 理では、イオン複合体、分子複合体、有機誘導体等を形成し、表面積や層 間距離を変えることができる。

本祭明で用いられるイオン交換性層状化合物は、イオン交換性を利用し、 層間の交換性イオンを別の大きな嵩高いイオンと交換することにより、層間が 拡大した状態の層状化合物であってもよい。このような嵩高いイオンは、層状 構造を支える支柱的な役割を担っており、通常、ピラーと呼ばれる。また、この ように層状化合物の層間に別の物質を導入することをインターカレーションと いう。インターカレーションするゲスト化合物としては、TiCl4、ZrCl4 等の陽イオ ン性無機化合物、Ti(OR)4、Zr(OR)4、PO(OR)3、B(OR)3 等の金属アルコキ 25 シド(R は炭化水素基等)、[Al<sub>13</sub>O<sub>4</sub>(OH)<sub>24</sub>]<sup>7+</sup>、[Zr<sub>4</sub>(OH)<sub>14</sub>]<sup>2+</sup>、 [Fe<sub>3</sub>O(OCOCH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]+等の金属水酸化物イオン等が挙げられる。これらの化合 物は単独でまたは2種以上組み合わせて用いられる。また、これらの化合物を インターカレーションする際に、Si(OR)4、Al(OR)3、Ge(OR)4 等の金属アルコ キシド(R は炭化水素基等)等を加水分解して得た重合物、SiO2等のコロイド

状無機化合物等を共存させることもできる。また、ピラーとしては、上記金属水酸化物イオンを層間にインターカレーションした後に加熱脱水することにより生成する酸化物等が挙げられる。

本発明で用いられる粘土、粘土鉱物、イオン交換性層状化合物は、そのまま用いてもよく、またボールミル、ふるい分け等の処理を行った後に用いてもよい。また、新たに水を添加吸着させ、あるいは加熱脱水処理した後に用いてもよい。さらに、単独で用いても、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

これらのうち、好ましいものは粘土または粘土鉱物であり、特に好ましいものはモンモリロナイト、バーミキュライト、ペクトライト、テニオライトおよび合成雲母10 である。

有機化合物としては、粒径が 10~300μm の範囲にある顆粒状ないしは微粒子状固体を挙げることができる。具体的には、エチレン、プロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン等の炭素原子数が 2~14 のオレフィンを主成分として生成される(共)重合体またはビニルシクロヘキサン、スチレンを主成分として生成される(共)重合体、およびそれらの変成体を例示することができる。

15

20

本発明に係るオレフィン重合用触媒は、上記遷移金属化合物(A1)及び(A2)、(b-1)有機金属化合物、(b-2)有機アルミニウムオキシ化合物、および(b-3)イオン化イオン性化合物から選ばれる少なくとも 1 種の化合物(B)、固体状担体(C)と共に、必要に応じて特定の有機化合物成分(D)を含むこともできる。このような有機化合物成分としては本出願人による特開平 11-315109号公報や EP0874005A1 中に開示された化合物を制限無く使用することができる。

重合の際には、各成分の使用法、添加順序は任意に選ばれるが、以下の ような方法を例示することができる。

- 25 [1] 成分(A1)及び成分(B)を担体(C)に担持した触媒成分、成分(A2)及び成分(B)を担体(C)に担持した触媒成分を任意の順序で重合器に添加する方法。
  - [2] 成分(A1)と成分(A2)と成分(B)とを担体(C)に担持した触媒成分を重合器に添加する方法。

上記[1]の方法においては、各触媒成分の少なくとも2つ以上は予め接触されていてもよい。

成分(B)が担持されている上記[1]及び[2]の各方法においては、必要に応じて担持されていない成分(B)を、任意の順序で添加してもよい。この場合成分(B)は、同一でも異なっていてもよい。

また、上記[1]及び[2]の担体(C)に成分(A1)、成分(A2)および成分(B) が担持された固体触媒成分は、オレフィンが予備重合されていてもよく、予備 重合された固体触媒成分上に、さらに、触媒成分が担持されていてもよい。

上記[1]における成分(A1)及び成分(B)の担体(C)への担持、あるいは成分(A2)及び成分(B)の担体(C)への担持は公知の方法に準じて容易に行うことができる。また、上記[2]における成分(A1)、成分(A2)及び成分(B)の担体(C)への担持は、以下の様に行うのが好ましい。

10

25

一つは、予め成分(A1)と成分(A2)を予備接触させた後、成分(B)が担持された担体(C)に接触させる方法であり、もう一つは、先ず成分(A1)[あるいは成分(A2)]を成分(B)が担持された担体(C)に接触させた後、次いで成分(A2)[あるいは成分(A1)]をこの成分(A1)[あるいは成分(A2)]及び成分(B)が担持された担体(C)に接触させる方法である。特に好ましくは、前者の、予め成分(A1)と成分(A2)を予備接触させた後、成分(B)が担持された担体(C)に接触させる方法である。

20 具体的には、成分(A1)と成分(A2)を任意の比率で不活性炭化水素系溶媒中に溶解させ、次いで成分(B)が担持された担体(C)に不活性炭化水素系溶媒中で接触させることにより成分(A1)、成分(A2)及び成分(B)を担体(C)へ担持させる方法である。

担持に用いる不活性炭化水素溶媒としては具体的には、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、ドデカン、灯油等の脂肪族炭化水素、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロペンタン等の脂環族炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、エチレンクロリド、クロルベンゼン、ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素またはこれらの混合物等を挙げることができる。成分(A1)と成分(A2)の予備接触時間は、通常0~

5 時間、好ましくは 0~1 時間、特に好ましくは 0~20 分であり、その後の成分 (B)が担持された担体 (C)に接触させる時間は、通常 0~24 時間、好ましくは 0~5 時間、特に好ましくは 0~2 時間である。これらの担持操作は、通常-50~200℃、好ましくは-50~50℃、特に好ましくは 0~40℃で行われる。成分 (A1)と成分 (A2)は、製造したいポリオレフィンの分子量及び分子量分布から任意に決定でき、その成分 (A1)と成分 (A2)のモル比 [(A1)/(A2)]は、成分 (A1)と成分 (A2)のそれぞれのオレフィン重合活性から求めることができる。 [(A1)/(A2)]は、通常 0.03~30、好ましくは、0.06~15 である。

なお、担体(C)に担持された成分(A1)及び成分(A2)中の全遷移金属原 10 子(M)は、誘導結合プラズマ発光分析法(ICP 分析法)により求めることがで きる。

成分(b-1)は、成分(b-1)と、成分(A1)及び成分(A2)中の全遷移金属原子(M)とのモル比[(b-1)/M]が、通常 0.01~100000、好ましくは 0.05~50000 となるような量で用いられる。成分(b-2)は、成分(b-2)中のアルミニウム原子と、成分(A1)及び成分(A2)中の全遷移金属原子(M)とのモル比[(b-2)/M]が、通常 10~500000、好ましくは 20~100000 となるような量で用いられる。成分(b-3)は、成分(b-3)と、成分(A1)及び成分(A2)中の全遷移金属原子(M)とのモル比[(b-3)/M]が、通常 1~10、好ましくは 1~5となるような量で用いられる。

成分(D)は、成分(B)が成分(b-1)の場合には、モル比[(D)/(b-1)]が通常 0.01~10、好ましくは 0.1~5 となるような量で、成分(B)が成分(b-2)の場合には、モル比[(D)/(b-2)]が通常 0.001~2、好ましくは 0.005~1 となるような量で、成分(B)が成分(b-3)の場合には、モル比[(D)/(b-3)]が通常 0.01 ~10、好ましくは 0.1~5 となるような量で用いられる。

20

**25** '

本発明に係るオレフィンの重合方法では、上記した重合用触媒の存在下に、オレフィンを重合または共重合することによりオレフィン重合体を得る。

本発明では、重合は溶解重合、懸濁重合等の液相重合法または気相重合法のいずれにおいても実施できる。

液相重合法において用いられる不活性炭化水素媒体として具体的には、

プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、ドデカン、灯油等の脂肪族炭化水素;シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロペンタン等の脂環族炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;エチレンクロリド、クロルベンゼン、ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素またはこれらの混合物等を挙げることができ、オレフィン自身を溶媒として用いることもできる。

上記のようなオレフィン重合用触媒を用いて、オレフィンの重合を行うに際して、成分(A1)及び(A2)は、反応容積 1 リットル当り、通常 10-12~10-1 モル、好ましくは 10-8~10-2 モルになるような量で用いられ、必要に応じて上述の特に 20有機化合物成分(D)を含むこともできる。

また、このようなオレフィン重合用触媒を用いたオレフィンの重合温度は、通常-50~+200℃、好ましくは 0~+170℃、特に好ましくは+60~+170℃の範囲である。重合圧力は、通常、常圧~100kg/cm²、好ましくは常圧~50kg/cm²の条件下であり、重合反応は、回分式、半連続式、連続式のいずれの方法においても行うことができる。さらに重合を反応条件の異なる 2 段以上に分けて行うことも可能である。

得られるオレフィン重合体の分子量は、重合系に水素を存在させるか、または重合温度を変化させることによって調節することができる。さらに、使用する成分(B)の違いにより調節することもできる。

20

. 25

このようなオレフィン重合用触媒により重合することができるオレフィンとしては既に述べた通りであるが、必要に応じて、炭素原子数が3~30、好ましくは5~20の環状オレフィン、たとえばシクロペンテン、シクロヘプテン、ノルボルネン、5-メチル-2-ノルボルネン、テトラシクロドデセン等;極性モノマー、たとえば、アクリル酸、メタクリル酸、フマル酸、無水マレイン酸等;アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸等のα,β-不飽和カルボン酸エステル;酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等のビニルエステル類;アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル等の不飽和グリシジル類;フッ化ビニル、塩化ビニル等のハロゲン化オレフィン類等を併用してもよい。

また、オレフィンとして、ビニルシクロヘキサン、ジエンまたはポリエン等を用い

PCT/JP2004/007124 WO 2004/104055

ることもできる。さらに、オレフィンとして、スチレン等の芳香族ビニル化合物、ジ ビニルベンゼン等の官能基含有スチレン誘導体等を併用することもできる。

このようにして得られたエチレン系重合体粒子は、以下のような方法によりペ レット化してもよい。

- 5 (1)エチレン系重合体粒子および所望により添加される他の成分を、押出機、 ニーダー等を用いて機械的にブレンドして、所定の大きさにカットする方法。
  - (2) エチレン系 重合体 および所望により添加される他の成分を適当な良溶媒 (例えば、ヘキサン、ヘプタン、デカン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエンお よびキシレン等の炭化水素溶媒)に溶解し、次いで溶媒を除去、しかる後に 押出機、ニーダー等を用いて機械的にブレンドして、所定の大きさにカット

10

25

する方法。

本発明に係わるエチレン系重合体には、本発明の目的を損なわない範囲 で、耐候性安定剤、耐熱安定剤、帯電防止剤、スリップ防止剤、アンチブロッ キング剤、防曇剤、滑剤、染料、核剤、可塑剤、老化防止剤、塩酸吸収剤、 酸化防止剤などの添加剤やカーボンブラック、酸化チタン、チタンイエロー、フ 15 タロシアニン、イソインドリノン、キナクリドン化合物、縮合アゾ化合物、群青、コ バルトブルー等の顔料が必要に応じて配合されていてもよい。

本発明に係るエチレン系重合体は、ブロー成形体、インフレーション成形体、 キャスト成形体、押出ラミ成形体、パイプや異形などの押出成形体、発泡成 形体、射出成形体などに成形することができる。さらに繊維、モノフィラメント、 20 不織布などに使用することができる。これらの成形体には、エチレン系重合体 からなる部分と、他の樹脂からなる部分とを含む成形体(積層体等)が含まれ る。なお、該エチレン系重合体は成形過程で架橋されたものを用いてもよい。 本発明に係るエチレン系重合体を、上記の成形体の中で、ブロー成形体およ びパイプや異形などの押出成形体に用いると優れた特性を与えるので好まし い。

本発明のエチレン系重合体は、ブロー成形により、ボトル容器、工業薬品 缶、ガソリンタンクなどに成形することができる。これらの成形体には、エチレン 系 重合体からなる部分と、他の樹脂からなる部分とを含む成形体(積層体等)

が含まれる。また、エチレン系重合体単層で成形することもできる。

内容液には塩素系漂白剤に代表される漂白剤一般や、界面活性剤にも 好適に用いることが可能である。

本発明のエチレン系重合体は、パイプや射出成形により成形されるパイプ 用継ぎ手などに成形することができる。これらの成形体には、エチレン(共)重 合体からなる部分と、他の樹脂からなる部分とを含む成形体(積層体等)が含 まれる。また、エチレン系共重合体単層で成形することもできる。

これらの成形体は酸化チタンあるいはフタロシアニン等の着色剤を用いて着 色することもできる。また、酸化防止剤や帯電防止剤等の添加剤を加えて機 10 能を付与した成形体として使用することができる。

以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこ れら実施例に限定されるものではない。

なお、本実施例において、エチレン/ヘキセン共重合体中のヘキセン含量 は FT-IR (SHIMAZU FTIR-8200D)を用いて決定した。 固体成分及び固体 触媒成分中の遷移金属原子濃度、Al 濃度は誘導結合プラズマ発光分析法 (ICP 分析法) により決定した。

#### 極限粘度([ n])

15

20

25

デカリン溶媒を用いて、135℃で測定した値である。 すなわち造粒ペレット約 20mgをデカリン15ml に溶解し、135℃のオイルバス中で比粘度 nspを測定す る。このデカリン溶液にデカリン溶媒を 5ml 追加して希釈後、同様にして比粘 度  $\eta_{sp}$  を測定する。この希釈操作をさらに 2 回繰り返し、濃度 (C)を 0 に外挿 した時の  $\eta_{sp}/C$  の値を極限粘度として求める(下式参照)。

[
$$\eta$$
]=lim( $\eta_{sp}$ /C) (C $\rightarrow$ 0)

#### 密 度 (d)

190℃に設定した神藤金属工業社製油圧式熱プレス機を用い、100kg/ cm<sup>2</sup>の圧力で0.5mm厚のシートを成形し(スペーサー形状; 240×240×0.5mm 厚の板に 45×45×0.5mm、9 個取り)、20℃に設定した別の神藤金属工業社 製油圧式熱プレス機を用い、100kg/cm²の圧力で圧縮することで冷却して 測定用試料を作成した。熱板は5mm厚のSUS板を用いた。このプレスシート

を 120℃で1時間熱処理し、1 時間かけて直線的に室温まで徐冷したのち、密 度勾配管で測定した。

重量平均分子量(Mw)、数平均分子量(Mn)および低分子量成分と高分子 量成分のポリマーブレンド比(BR)

ウォーターズ社製 GPC-150C を用い以下のようにして測定した。分離カラム は、TSKgel GMH6-HT 及び TSKgel GMH6-HTL であり、カラムサイズはそれ ぞれ内径 7.5mm、長さ 600mm であり、カラム温度は 140℃とし、移動相には o-ジクロロベンゼン(和 光 純 薬 工 業) および酸 化 防 止 剤 として BHT(武 田 薬 品)0.025 重量%を用い、1.0ml/min で移動させ、試料濃度は 0.1 重量%とし、 試料注入量は 500 μ1 とし、検出器として示差屈折計を用いた。標準ポリスチ レンは、分子量が Mw<1,000 および Mw>4×106 については東ソー社製を用 い、1,000≤Mw≤4×106 についてはプレッシャーケミカル社製を用いた。分子 量計算は、ユニバーサル校正して、ポリエチレンに換算して求めた値である。 分子量曲線の分離

15 マイクロソフト社製エクセル(登録商標)97 のビジュアル・ベーシックを用いて プログラムを作成した。分離する2つの曲線は対数正規分布として、収束計算 により分子量分布曲線を分子量が異なる2つの曲線に分離した。分離した2 つの曲線を再合成した曲線と GPC で実測した分子量曲線とを比較して、両 者がほぼ一致するように初期値を変更しながら計算を実行する。計算は Log 20 (分子量)を 0.02 間隔に分割して行う。実測した分子量曲線の面積と分離し た2つの曲線を再合成した曲線の面積とが1になるように強度を規格化し、各 分子量における実測の強度(高さ)と再合成した曲線の強度(高さ)との差の 絶対値を実測の強度(高さ)で割った値が、分子量が 10,000~1,000,000 の **範囲で0.4以下、好ましくは0.2以下、より好ましくは0.1以下であり、2つに分** 離したピークの最大位置では 0.2 以下、好ましくは 0.1 以下となるまで曲線の 分離計算を繰り返す。この際、低分子量側に分離されたピークの Mw/Mnと 高分子量側に分離されたピークの Mw/Mn との差が 1.5 以下となるようにす る。低分子量成分と高分子量成分のポリマーブレンド比(BR)は下記式で算 出した。

25

 $BR = S_L/S_H$ 

S<sub>L</sub>; GPC チャートにおける低分子量成分側の面積 S<sub>H</sub>; GPC チャートにおける高分子量成分側の面積

## MFR の測定

メルトフローレートは、下記のように測定する。すなわち、JIS K7210 に準じて製作されたテスター産業(株)製自動MFR測定計に、JIS K7210 に規定する寸法を満たすオリフィスを取付け、バレル(試料を入れる部分)を 190℃に昇温し、保持する。バレルに試料 4g を入れ、ピストンを装着し、気泡抜きを行い、6分間予熱する。予熱後、2.16Kgまたは 21.6kg の荷重を加えて試料を押出し、10分間当たりに押し出される試料の重量を算出しメルトフローレートとする。

### MT の測定

10

20

25

メルトテンション(MT)は、溶融させたエチレン系重合体を一定速度で延伸したときの応力を測定することにより決定される。すなわち、東洋精機製作所製、MT 測定機を用い、樹脂温度 190℃、押し出し速度 15mm/分、巻取り速度 7.85m/分、ノズル径 2.09mmφ、ノズル長さ 8mm の条件で行った。

## スウェル比の測定

スウェル比は、下記のように測定する。すなわち、東洋精機製作所製 キャピログラフーIB にノズル径  $(D_0)$ =3.0mm $\phi$ 、長さ(L)=3mmのノズルを取り付け、バレル(試料を入れる部分)を 190℃に昇温し、保持する。バレルに試料約10gを入れ、ピストンを装着し、気泡抜きを行い、6分間予熱する。予熱後、0.25、0.5、1、2.5、5、10、25sec-1の各ずり速度で試料を押出し、ノズル出口より15mm下方のストランド径  $(D_i)$ をレーザー光線により測定する。このようにして測定したストランド径  $(D_i)$ とノズル径  $(D_0)$ との比  $(SR_i = D_i/D_0)$ を求める。

半対数方眼紙に各ずり速度に対するSRiをプロットし得られた曲線より、ずり速度 9.98sec-1 のときの値を読み取り、スウェル比とする。

# 流動の活性化エネルギー(Ea)の測定

Ea は下記のように測定する。 すなわち、TA インスツルメント社製ストレスレオメータ SR-5000 を用い、窒素雰囲気下、150℃, 190℃, 230℃の各温度にて 0.1rad/sec から 100rad/sec の測定周波数範囲にて溶融粘弾性測定を行う。

樹脂にせん断を加えるための冶具としては直径 25mm のパラレルプレートを使用する。各温度で得られる流動曲線から 190 でを基準温度にマスターカーブを作成し、そのシフトファクター $a_T$  の温度依存性から、アレニウスの式  $\log a_T = (Ea/2.303R)[(1/T)-(1/T_0)]$  (R: 気体定数, T: 絶対温度,  $T_0:$  基準温度) を用いて Ea を算出する。

また、本実施例及び比較例で用いた第 4 族遷移金属化合物(A1)および (A2)は、既述の方法によって合成した。

# [固体成分(E)の調製]

窒素流通下、150℃で5時間乾燥したシリカ(旭硝子社製)30gを466mlの10 トルエンに懸濁した後、メチルアルモキサンのトルエン溶液(Al 原子換算で308mmol/ml)134.3mlを25℃で30分かけて滴下した。滴下終了後、30分かけて114℃まで昇温し、その温度で4時間反応させた。その後60℃まで降温し、上澄み液をデカンテーションにより除去した。このようにして得られた固体成分をトルエンで3回洗浄した後、トルエンを加え、固体成分(E)のトルエンスラリーを調製した。得られた固体成分(E)の一部を採取し、濃度を調べたところ、スラリー濃度;0.1189g/ml、Al 濃度;0.8377mmol/mlであった。

#### 【実施例1】

# [固体触媒成分(F)の調製]

窒素置換した300mlのガラス製フラスコにトルエン71.05mlを入れ、攪拌下、 上記で調製した固体成分(E)のトルエンスラリー8.95ml(固体部換算で 1.06g)を装入した。次に、下記化合物(1) 0.0165mmol 及び下記化合物 (2)0.0135mmolを含むトルエン溶液 20.0mlを15分かけて滴下し、室温で1 時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションにより除去し、ヘプタン で3回洗浄し、ヘプタン100mlを加えて固体触媒成分(F)のヘプタンスラリー を調製した。得られた固体触媒成分(F)のヘプタンスラリーの一部を採取して 濃度を調べたところ、Zr 濃度;0.000201mmol/ml、Al 濃度;0.0615mmol/mlであった。

#### [重合]

充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温でヘプタン 500ml を装入し、エチレンで液相および気相を飽和させた。その後、1-ヘキセンを 3ml、トリイソブチルアルミニウム(東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液 (アルミニウム原子換算 0.5mmol/ml)を 1.0ml、固体触媒成分(F)0.746ml (ジルコニウム換算 0.00015mmol)加え、80℃に昇温し、全圧が 8kg/cm²-G になるようエチレン/水素混合ガス(水素濃度:0.06mol%)を供給しながら、3 時間重合を行った。重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行った。

得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。 得られたエチレン/1-ヘキセン共重合体は、28.5gであり、ジルコニウム 1mmol 当たりの重合活性は 190kg/mmol であった。ヘキセン含量は 0.48mol%、 [ η]は 3.54dl/g、Mw、Mw/Mn、BR はそれぞれ 235000、15.25、53/47 で あった。

# 【実施例 2】

10

15

20

# [固体触媒成分(G)の調製]

室素置換した300mlのガラス製フラスコにトルエン35.52mlを入れ、攪拌下、上記で調製した固体成分(E)のトルエンスラリー4.48ml(固体部換算で0.533g)を装入した。次に、上記実施例1で使用した化合物(1)0.0128mmol及び下記の化合物(3)0.0022mmolを含むトルエン溶液10.0mlを15分かけて滴下し、室温で1時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションに

より除去し、ヘプタンで 3 回洗浄し、ヘプタン 100ml を加えて固体触媒成分 (G)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分 (G)のヘプタンスラリーの一部を採取して濃度を調べたところ、Zr 濃度;0.000105mmol/ml、Al 濃度;0.0328mmol/ml であった。

# [重合]

充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温で n-ヘプタン 500ml を装入し、エチレンで液相および気相を飽和させた。その後、1-ヘキセンを 3ml、トリイソブチルアルミニウム(東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液 (アルミニウム原子換算 0.5mmol/ml)を 1.0ml、固体触媒成分(G) 0.762ml (ジルコニウム換算 0.00008mmol)加え、80℃に昇温し、全圧が 8kg/cm²-G になるようエチレン/水素混合ガス(水素濃度:0.06mol%)を供給しながら、3 時間重合を行った。重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行った。

得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。 得られたエチレン/1-ヘキセン共重合体は、18.7gであり、ジルコニウム 1mmol 当たりの重合活性は 234kg/mmol であった。ヘキセン含量は 0.32mol%、 [ η] は 3.39dl/g、Mw、Mw/Mn、BR はそれぞれ 240000、15.91、54/46 で あった。

### 【実施例3】

20

25

#### [固体触媒成分(H)の調製]

窒素置換した 300ml のガラス製フラスコにトルエン 35.52ml を入れ、攪拌下、上記で調製した固体成分(E)のトルエンスラリー4.48ml(固体部換算で

0.533g)を装入した。次に、下記の化合物(4)0.0116mmol 及び上記実施例2で使用した化合物(3)0.0034mmolを含むトルエン溶液10.0mlを15分かけて滴下し、室温で1時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションにより除去し、ヘプタンで3回洗浄し、ヘプタン100mlを加えて固体触媒成分(H)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(H)のヘプタンスラリーの一部を採取して濃度を調べたところ、Zr濃度;0.000110mmol/ml、Al濃度;0.0280mmol/mlであった。

# 15 [重合]

5

10

20

25

充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温でヘプタン 500ml を装入し、エチレンで液相および気相を飽和させた。その後、1-ヘキセンを 3ml、トリイソブチルアルミニウム(東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液 (アルミニウム原子換算 0.5mmol/ml)を 1.0ml、固体触媒成分(H) 0.455ml (ジルコニウム換算 0.00005mmol)加え、80℃に昇温し、全圧が 8kg/cm²-G になるようエチレン/水素混合ガス(水素濃度:0.06mol%)を供給しながら、3 時間重合を行った。重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行った。

得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。 得られたエチレン/1-ヘキセン共重合体は、22.6g であり、ジルコニウム 1mmol 当たりの重合活性は 452kg/mmol であった。ヘキセン含量は 0.67mol%、 [ η] は 3.89dl/g、Mw、Mw/Mn、BR はそれぞれ 207000、18.64、56/44 で あった。

#### 【実施例4】

### [固体触媒成分(J)の調製]

窒素置換した 300ml のガラス製フラスコにトルエン 35.52ml を入れ、攪拌下、上記で調製した固体成分(E)のトルエンスラリー4.48ml(固体部換算で0.533g)を装入した。次に、上記実施例 3 で使用した化合物(4)0.006mmol 及び上記実施例 2 で使用した化合物(3)0.009mmol を含むトルエン溶液10.0mlを15分かけて滴下し、室温で1時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションにより除去し、ヘプタンで3回洗浄し、ヘプタン100mlを加えて固体触媒成分(J)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(J)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(J)のヘプタンスラリーの一部を採取して濃度を調べたところ、Zr 濃度;0.000121mmol/ml、Al 濃度;0.0307mmol/mlであった。

### [重合]

10

15

20

25

充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温でヘプタン 500ml を装入し、エチレンで液相および気相を飽和させた。その後、1-ヘキセンを 3ml、トリイソブチルアルミニウム(東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液 (アルミニウム原子換算 0.5mmol/ml)を 1.0ml、固体触媒成分(J)0.207ml (ジルコニウム換算 0.000025mmol)加え、80℃に昇温し、全圧が 8kg/cm²-G になるようエチレンを供給しながら、3 時間重合を行った。重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行った。

得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80<sup>°</sup>Cにて 10 時間減圧乾燥した。 得られたエチレン /1- ヘキセン共重合体は、30.2g であり、ジルコニウム 1mmol 当たりの重合活性は 1210kg/mmol であった。ヘキセン含量は 0.85mol<sup>°</sup>%、[ $\eta$ ]は 3.10dl/g、Mw、Mw/Mn、BR はそれぞれ 337000、12.39、41/59であった。

#### 【実施例5】

#### [固体触媒成分(K)の調製]

窒素置換した300mlのガラス製フラスコにトルエン35.52mlを入れ、攪拌下、上記で調製した固体成分(E)のトルエンスラリー4.48ml(固体部換算で0.533g)を装入した。次に、下記の化合物(5)0.00975mmol 及び上記実施例2で使用した化合物(3)0.00525mmol を含むトルエン溶液 10.0ml を 15

分かけて滴下し、室温で1時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションにより除去し、ヘプタンで3回洗浄し、ヘプタン100mlを加えて固体触媒成分(K)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(K)のヘプタンスラリーの一部を採取して濃度を調べたところ、Zr濃度; 0.000117mmol/ml、Al 濃度; 0.0321mmol/ml であった。

化合物(5)

10

15

5

#### [重合]

充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温でヘプタン 500ml を装入し、エチレンで液相および気相を飽和させた。その後、1-ヘキセンを 3ml、トリイソブチルアルミニウム(東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液 (アルミニウム原子換算 0.5mmol/ml)を1.0ml、固体触媒成分(K)0.214ml (ジルコニウム換算 0.000025mmol)加え、80℃に昇温し、全圧が8kg/cm²-G になるようエチレン/水素混合ガス(水素濃度:0.06mol%)を供給しながら、3 時間重合を行った。重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行った。

20 得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。 得られたエチレン/ヘキセン共重合体は、14.0g であり、ジルコニウム 1mmol 当たりの重合活性は 560kg/mmol であった。ヘキセン含量は 0.60mol%、 [ η]は 4. 01dl/g、Mw、Mw/Mn、BR はそれぞれ 189000、12.68、43/57 で あった。

#### 25 【実施例 6】

#### 「固体触媒成分(L)の調製]

窒素置換した 300ml のガラス製フラスコにトルエン 35.52ml を入れ、攪拌下、上記で調製した固体成分 (E)のトルエンスラリー4.48ml (固体部換算で 0.533g)を装入した。次に、上記実施例 5 で使用した化合物 (5)0.0105mmol

及び下記化合物(6)0.0045mmolを含むトルエン溶液 10.0mlを 15 分かけて滴下し、室温で1時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションにより除去し、ヘプタンで 3 回洗浄し、ヘプタン 100mlを加えて固体触媒成分(L)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(L)のヘプタンスラリーの一部を採取して濃度を調べたところ、Zr 濃度;0.000120mmol/ml、Al 濃度;0.0324mmol/mlであった。

化合物(6)

### [重合]

5

15 充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温でヘプタン 500ml を装入し、エチレンで液相および気相を飽和させた。その後、1-ヘキセンを 3ml、トリイソプチルアルミニウム(東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液 (アルミニウム原子換算 0.5mmol/ml)を 1.0ml、固体触媒成分(L)0.208ml (ジルコニウム換算 0.000025mmol)加え、80℃に昇温し、全圧が 8kg/cm²-G になるようエチレン/水素混合ガス(水素濃度:0.06mol%)を供給しながら、3 時間重合を行った。重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行った。

得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。 得られたエチレン/ヘキセン共重合体は、14.6g であり、ジルコニウム 1mmol 当たりの重合活性は 584kg/mmol であった。ヘキセン含量は 0.55mol%、 [ η]は 4.34dl/g、Mw、Mw/Mn、BR はそれぞれ 234000、24.67、41/59で あった。

#### 【実施例7】

25

[固体触媒成分(M)の調製]

PCT/JP2004/007124 WO 2004/104055

窒素置換した300mlのガラス製フラスコにトルエン35.52mlを入れ、攪拌下、 上記で調製した固体成分(E)のトルエンスラリー4.48ml(固体部換算で 0.533g)を装入した。次に、上記実施例 5 で使用した化合物 (5) 0.0105mmol 及び下記の化合物 (7) 0.0045 mmol を含むトルエン溶液 10.0 ml を 15 分かけ て滴下し、室温で1時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションに より除去し、ヘプタンで 3 回洗浄し、ヘプタン 100ml を加えて固体触媒成分 (M)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(M)のヘプタンス ラリーの一部を採取して濃度を調べたところ、Zr 濃度;0.000125mmol/ml、 Al 濃度; 0.0317mmol/ml であった。

# [重合]

20

**25** ·

**5**.

充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温でヘプタン 500ml を装入し、エチレンで液相および気相を飽和させた。その後、1-ヘキセ ンを 3ml、トリイソブチルアルミニウム(東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液 (アルミニウム原子換算 0.5mmol/ml)を1.0ml、固体触媒成分(M)0.200ml (ジルコニウム換算 0.000025mmol)加え、80℃に昇温し、全圧が 8kg/cm²-G になるようエチレン/水素混合ガス(水素濃度:0.06mol%)を供給しながら、3 時間重合を行った。重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行っ た。

得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。 得られたエチレン/ヘキセン共重合体は、16:0g であり、ジルコニウム 1mmol 当たりの重合活性は 640kg/mmol であった。ヘキセン含量は 0.58mol%、 [ η] は 3. 87dl/g、Mw、Mw/Mn、BR はそれぞれ 264000、29.06、45/55 で

あった。

#### 【比較例1】

[固体触媒成分(N)の調製]

窒素置換した300mlのガラス製フラスコにトルエン71.05mlを入れ、攪拌下、上記で調製した固体成分(E)のトルエンスラリー8.95ml(固体部換算で1.06g)を装入した。次に、上記実施例1で使用した化合物(1)0.03mmolを含むトルエン溶液20.0mlを15分かけて滴下し、室温で1時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションにより除去し、ヘプタンで3回洗浄し、ヘプタン100mlを加えて固体触媒成分(N)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(N)のヘプタンスラリーの一部を採取して濃度を調べたところ、Zr濃度;0.000270mmol/ml、Al濃度;0.0689mmol/mlであった。

# [重合]

10

15

20

25

充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温でヘプタン 500ml を装入し、エチレンで液相および気相を飽和させた。その後、トリイソブ チルアルミニウム (東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液 (アルミニウム原子 換算 0.5mmol/ml)を 0.5ml、固体触媒成分 (N) 1.11ml (ジルコニウム換算 0.003mmol)加え、80 に昇温し、全圧が 8kg/cm2-G になるようエチレン/ 水素混合ガス (水素濃度: 2.53mol%)を供給しながら、107 分間重合を行った。重合後、脱圧し、窒素置換を行い用いたエチレン/水素混合ガスを除去した。

この SUS 製 1 リットルオートクレーブにトリイソブチルアルミニウム(東ソーファ インケム社製)のヘプタン溶液(アルミニウム原子換算 0.5mmol/ml)を 0.5ml、1-ヘキセン 5ml を装入し、全圧が 8kg/cm²-G になるようエチレン/水素混合 ガス(水素濃度:0.0305mol%)を供給した後、80℃で 17 分間再度重合した。 重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行った。

得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。 得られたエチレン/ヘキセン共重合体は、100.4gであり、ジルコニウム 1mmol 当たりの重合活性は 33kg/mmol であった。ヘキセン含量は 0.67mol%、 [ η]は 4.11dl/g、Mw、Mw/Mn、BR はそれぞれ 299000、32.68、54/46 で

あった。

10

15

20

25

#### 【実施例8】

### [固体成分(O)の調製]

窒素流通下、150℃で5時間乾燥したシリカ(旭硝子社製)30gを400mlのトルエンに懸濁した後、メチルアルモキサンのトルエン溶液(A1 原子換算で300mmol/ml)207.6mlを25℃で30分かけて滴下した。滴下終了後、30分かけて114℃まで昇温し、その温度で4時間反応させた。その後60℃まで降温し、上澄み液をデカンテーションにより除去した。このようにして得られた固体成分をトルエンで3回洗浄した後、トルエンを加え、固体成分(O)のトルエンスラリーを調製した。得られた固体成分(O)の一部を採取し、濃度を調べたところ、スラリー濃度;0.08123g/ml、A1濃度;0.7339mmol/mlであった。

### [固体触媒成分(P)の調製]

窒素置換した300mlのガラス製フラスコにトルエン35.0mlを入れ、攪拌下、上記で調製した固体成分(O)のトルエンスラリー5.11ml(固体部換算で0.415g)を装入した。次に、上記実施例6で使用した化合物(5)0.0060mmol及び化合物(6)0.0090mmolを含むトルエン溶液20.0mlを15分かけて滴下し、室温で1時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションにより除去し、ヘプタンで3回洗浄し、ヘプタン100mlを加えて固体触媒成分(P)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(P)のヘプタンスラリーの一部を採取して濃度を調べたところ、Zr濃度;0.000126mmol/ml、Al濃度;0.0347mmol/mlであった。

### [重合]

充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温でヘプタン 500ml を装入し、エチレン/水素混合ガス(水素濃度:0.101mol%)で液相 および気相を飽和させた。その後、1-ヘキセンを 3ml、トリイソブチルアルミニウム (東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液(アルミニウム原子換算 1.0mmol/ml)を 0.5ml、固体触媒成分(P)を 0.59ml(ジルコニウム換算 0.000075mmol)加え、65℃に昇温し、全圧が8kg/cm²-G になるようエチレン /水素混合ガス(水素濃度:0.101mol%)を供給しなが6、3 時間重合を行っ

た。重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行った。

得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80<sup> $\circ$ </sup> にて 10 時間減圧乾燥した。 得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの重 合活性、ヘキセン含量、 $[\eta]$ 、Mw、Mw/Mn およびポリマーブレンド比 (BR) を表 1 に示す。

### 【実施例9】

**Έ** 

実施例 8 においてエチレン/水素混合ガス中の水素濃度を 0.153mol%に変更した以外は同様にして重合を行なった。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。

得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの重合活性、ヘキセン含量、 $\left[ \ \eta \right]$ 、M w、M w/M n およびB R を表 1 に示す。 【実施例 10】

実施例 8 において固体触媒成分 (P) の仕込み量を 0.79 ml (ジルコニウム換算 0.00010 mmol)、エチレン/水素混合ガス中の水素濃度を 0.064 mol%、重合温度を  $60 \text{ }^{\circ}$  に変更した以外は同様にして重合を行なった。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、 $80 \text{ }^{\circ}$  にて 10 時間減圧乾燥した。

得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの重合活性、ヘキセン含量、 $[\eta]$ 、Mw、Mw/Mn およびBR を表 1 に示す。 【実施例 11】

20 実施例 8 において固体触媒成分(P)の仕込み量を1.19ml(ジルコニウム換算 0.00015mmol)、1-ヘキセンを0ml、エチレン/水素混合ガス中の水素濃度を 0.062mol%に変更した以外は同様にして重合を行なった。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて10時間減圧乾燥した。

得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1mmol 当たりの 25 重合活性、ヘキセン含量、[η]、Mw、Mw/Mn およびBR を表 1 に示す。 【実施例 12】

実施例 11 においてエチレン/水素混合ガス中の水素濃度を 0.153 mol%に変更した以外は同様にして重合を行なった。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。

得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの 重合活性、ヘキセン含量、[n]、Mw、Mw/Mn およびBR を表 1 に示す。 表 1

	収量	重合活性	ヘキセン含量	[η]	Mw	Mw/Mn	BR
	(g)	(kg/mmol-Zr)	(mol%)	(dl/g)	14144	14144 / 14111	
実施例8	28.8	384	0.44	3.87	160000	18.2	52/48
実施例 9	35.7	476	0.28	<b>1.77</b>	76800	8.8	60/40
実施例10	42.9	429	0.22	1.82	82900	7.7	65/35
実施例11	67	446	-	2.07	103500	8.7	56/44
実施例12	56	373	, <b>-</b>	1.72	60900	8.8	54/46

### 【実施例 13】

### [固体触媒成分(Q)の調製]

窒素置換した300mlのガラス製フラスコにトルエン35.0mlを入れ、攪拌下、上記で調製した固体成分(O)のトルエンスラリー5.11ml(固体部換算で0.415g)を装入した。次に、下記化合物(8)0.0060mmol 及び上記実施例 6で使用した化合物(6)0.0090mmol を含むトルエン溶液 20.0mlを 15 分かけて滴下し、室温で 1 時間反応させた。その後、上澄み液をデカンテーションにより除去し、ヘプタンで 3 回洗浄し、ヘプタン 100ml を加えて固体触媒成分(Q)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(Q)のヘプタンスラリーを調製した。得られた固体触媒成分(Q)のヘプタンスラリーの一部を採取して濃度を調べたところ、Zr 濃度;0.000120mmol/ml、Al 濃度;0.0318mmol/ml であった。

**15** 

### [重合]

10

充分に窒素置換した SUS 製 1 リットルオートクレーブに、室温でヘプタン 500mlを装入し、エチレン/水素混合ガス(水素濃度:0.064mol%)で液相 および気相を飽和させた。その後、1-ヘキセンを 3ml、トリイソブチルアルミニウム (東ソーファインケム社製)のヘプタン溶液 (アルミニウム原子 換算 1.0mmol/ml)を 0.5ml、固体触媒成分(Q)を 0.63ml(ジルコニウム換算 0.000075mmol)加え、65℃に昇温し、全圧が 8kg/cm²-G になるようエチレン/水素混合ガス(水素濃度:0.064mol%)を供給しながら、3 時間重合を行った。重合の停止は少量のメタノールを添加することにより行った。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。

得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの重合活性、ヘキセン含量、[n]、Mw、Mw/Mn およびBR を表 2 に示す。 【実施例 14】

重合例 13 においてエチレン/水素混合ガス中の水素濃度を 0.101mol% 15 に変更した以外は同様にして重合を行なった。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。

得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの 重合活性、ヘキセン含量、 $[\eta]$ 、Mw、Mw/Mn およびBR を表 2 に示す。 【実施例 15】

20 重合例 13 においてエチレン/水素混合ガス中の水素濃度を 0.153 mol%に変更した以外は同様にして重合を行なった。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。

得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの 重合活性、ヘキセン含量、 $[\eta]$ 、M w、M w/M n およびB R を表 2 に示す。

### 25 【実施例 16】

実施例 13 において固体触媒成分 (Q)の仕込み量を 0.84ml (ジルコニウム 換算 0.00010mmol)、重合温度を 60℃に変更した以外は同様にして重合を 行なった。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧 乾燥した。 得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの重合活性、ヘキセン含量、 $\left[ \begin{array}{c} \eta \end{array} \right]$ 、M w、M w/M n およびB R を表 2 に示す。

#### 【実施例 17】

実施例 13 において固体触媒成分 (Q)の仕込み量を 1.26ml (ジルコニウム 換算 0.00015mmol)、1-ヘキセンを 0 ml に変更した以外は同様にして重合を 行なった。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧 乾燥した。

得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの 重合活性、ヘキセン含量、 $\begin{bmatrix} \eta \end{bmatrix}$ 、M w、M w/M n およびB R を表 2 に示す。

### 10 【実施例 18】

実施例 16 においてエチレン/水素混合ガス中の水素濃度を 0.153mol%に変更した以外は同様にして重合を行なった。得られたポリマーをヘキサンで洗浄した後、80℃にて 10 時間減圧乾燥した。

得られたエチレン/ヘキセン共重合体の収量、ジルコニウム 1 mmol 当たりの 1 mmol 15 重合活性、ヘキセン含量、[n]、1 mmol 、1 mmol が 1 mmol が  $1 \text{m$ 

収量 重合活性 ヘキセン含量  $[\eta]$ Mw/Mn BR Mw (dl/g)(g). (kg/mmol-Zr) (mol%) 5 66/34 実施例13 3.04 151100 44.7 597 0.24 62/38 実施例14 30.9 413 0.22 3.04 142300 13.4 93800 10.4 65/35 実施例15 46.2 616 0.22 2.36 4.1 64/36 535 0.18 2.52 113100 実施例16 53.5 実施例17 4.6 58/42 **75.3**° 502 2.87 134400 実施例18 2.22 104800 9.9 64/36 53 353

表 2

# 物性評価結果

上記実施例で合成したエチレン系重合体の物性を表3に示す。

l	MFR <sub>2</sub>	MFR <sub>20</sub>	密度	MT			Ea	[η]		: .
•	(g/10min)	(g/10min)			α <sup>1)</sup>	スウェル比	(KJ/mol)	(dl/g) .	β <sup>2)</sup>	Mw/Mn
	(g/ Tonilli)	(g/ tonini)	(kg/m³)	g			(KJ/ HIOI)	(41/8)	,	
実施例 9	0.37	66	960	9	5.53	1.6	26	1.77	1.98	<b>'8.8</b>
実施例10	0.52	75	962	9	4.59	1.7	26	1.82	1.91	7.7
実施例11	0.29	29.	965	13.5	6.32	1.6	25	2.07	2.46	8.7
実施例12	2.09	120	966	4	2.13	1.4	24	1.72	1.65	8.8
実施例13	0.03	5	952	32	22.02	1.7	24	3.04	3.49.	5
実施例14	0.03	4	950	30	22.02	1.7	25	.3.04	3.58	13.4
実施例15	0.26	18	953	10.5	6.71	1.6	26	2.36	2.71	10.4
実施例16	0.25	15	953	11.5	6.86	1.7	25	2.52	2.81	4.1
実施例17	0.13	9	.957	14	9.83	1.7	<b>26</b> .	2.87	3.14	4.6
実施例18	0.59	23	960	6.5	4.28	1.8	23	2.22	2.57	9.9

1)  $\alpha: 3.2*MFR_2^{-0.55}$ ,

2)  $\beta$ : 4.35-1.3 $\log$ MFR<sub>20</sub>

表 3 に示すように本実施例で得られたエチレン系重合体はすべてクレームのパラメーター規定の範囲内であることがわかる。

比較として従来公知のエチレン系重合体の物性値を表4及び表5に示す。 これらの比較例または参考例に記載した公知樹脂に関しては、MFR<sub>2</sub>とMTの 関係の規定から外れているか、および/又は Ea が 30KJ/mol 以上であり、請 求の範囲外であることは明らかである。

比較例 1:製品名ウルトゼックス(三井化学製)銘柄名 UZ2510F

比較例 2:製品名ウルトゼックス(三井化学製)銘柄名 UZ2520F

10 比較例 3:製品名ハイゼックス(三井化学製)銘柄名 HZ8200B

比較例 4:製品名エボリュー(三井化学製)銘柄名 SP2520

比較例 5:製品名エボリュー(三井化学製)銘柄名 SP2040

比較例 6:製品名ハイゼックス(三井化学製)銘柄名 6008B

比較例 7:製品名ミラソン(三井化学製)銘柄名 F9725

15 比較例 8:製品名ミラソン(三井化学製)銘柄名 M11

表 4

	DH KE H	MFR <sub>2</sub>	MFR <sub>20</sub>	MT	1)	[η]	.: (2)	Ea
	銘柄名	(g/10 min)	(g/10 min)	(g)	α <sup>1)</sup>	(dl/g)	β <sup>2)</sup>	(KJ/mol)
比較例1	UZ2510F	1.32	<u> </u>	1.8	2.75	1.83		27
比較例2	UZ2520F	2.47		1.25	1.95	1.59		26
比較例3	HZ8200B	0.03	5.3	20.4	22.02	3.54	3.4	33
比較例4	SP2520	1.83	<u> </u>	0.85	2.3	1.73		25
比較例5	SP2040	3.8	<del>-</del>	0.5	1.54	1.51		25
比較例6	HZ6008B	0.36	35	8	5.61	2.45	2.34	- 30
比較例7	F9725	1.14	· <del>-</del>	8	2.98	1.17· i	± 1.	42
比較例8	M11	7.91	· <del>-,</del> .	3.6	1.03	1.1	· <u></u>	46

1)  $\alpha: 3.2*MFR_2^{-0.55}$ , 2)  $\beta: 4.35-1.3logMFR_{20}$ 

参考例 1:製品名ハイゼックス(三井化学製)銘柄名 HZ9200B

参考例 2:製品名ハイゼックス(三井化学製)銘柄名 HZ5300B

参考例 3:製品名ミラソン(三井化学製)銘柄名 MR102J

参考例 4:製品名ミラソン(三井化学製)銘柄名 MRFF999

表 5

		銘柄名	MFR <sub>20</sub>	[η]	β <sup>1)</sup>	Ea
		<b>班们7</b> 2	(g/10 min)	(dl/g)	Р	(KJ/mol)
	参考例1	HZ9200B	2.11	4.2	3.92	35
I	参考例2	HZ5300B	48	2.4	2.16	32
I	参考例3	MR102J	17	1.71	2.75	50
ı	参考例4	MRF999	43	1.19	2.26	43

1)  $\beta$ : 4.35-1.3logMFR<sub>20</sub>

# 産業上の利用可能性

10

本発明のエチレン系重合体は成形性に優れ、機械的強度や外観に優れた成形体を提供する。本発明に係るエチレン系重合体ブロー成形体およびパイプや異形などの押出成形体に用いると優れた特性を与える。本発明に係るオレフィン重合触媒および重合方法は、単段重合においてさえも上記の優れた物性を示すエチレン系重合体を高い重合活性で製造することができる。

# 請求の範囲

1.

エチレンと炭素数 3~10 の  $\alpha$ -オレフィンから得られる共重合体であって、下記要件(i)、(ii)、(iii)および(iv)を同時に満たすエチレン系重合体。

- 5 (i) 190℃における、2.16kg 荷重でのメルトフローレート[MFR2(g/10min)]が 0.01~10 の範囲にあること。
  - (ii) メルトテンション[MT(g)]と前記メルトフローレート[MFR2(g/10min)]が、

 $MT \ge 3.2 \times MFR_2^{-0.55}$ 

で表わされる関係式を満たすこと。

- 10 (iii) 流動の活性化エネルギ-[Ea]が、30(KJ/mol)未満であること。
  - (iv) スウェル比が 1.36 以上であること。

2.

- (A1)下記一般式[I]で表される第4族遷移金属化合物、
- 15 (A2)下記一般式[II]で表される第4族遷移金属化合物、並びに
  - (B)(b-1) 有機金属化合物、
    - (b-2) 有機アルミニウムオキシ化合物、および
    - (b-3) 遷移金属化合物(A1)又は(A2)と反応してイオン対を形成する化合物、から選ばれる少なくとも1種の化合物が
- 20 (C) 固体状担体に担持されている固体状触媒成分の存在下、エチレンと炭素数  $3\sim10$  の  $\alpha$ -オレフィンを共重合することにより得られる請求の範囲第 1 項に記載のエチレン系重合体。

[式中、Mは周期律表第4族遷移金属原子を示し、mは、1~4の整数を示し、R¹は、分岐状または直鎖状脂肪族炭化水素基、置換基を有していてもよい脂環式炭化水素基で、R²~R6は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよい。また、mが2の場合にはR²~R6で示される基のうち2個の基が連結されていてもよく(但し、R¹同士が結合されることはない)。nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合は、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。]

15 
$$R^8$$
  $R^9$   $R^{10}$   $R^{19}$   $R^{19}$   $R^{20}$   $R^{18}$   $R^{11}$   $R^{12}$   $R^{16}$   $R^{15}$   $R^{14}$   $R^{13}$ 

.10

25

ル基であり、 $R^{19}$  と  $R^{20}$  がいずれも無置換アリール基またはいずれも置換アリール基である場合、 $R^{19}$  と  $R^{20}$  が同一でも異なっていてもよい。)

3.

請求の範囲第1項または第2項に記載のエチレン系重合体からなる単層または多層のブロー成形体。

4.

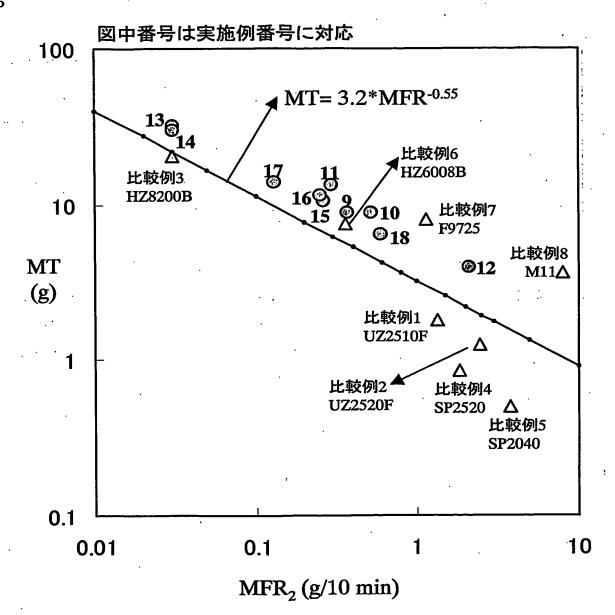
成形体が、ドラム缶、1000 リットルコンテナー、ガソリンタンク、工業薬品缶ま 10 たはボトル容器であることを特徴とする請求の範囲第3項に記載の単層または 多層のプロー成形体。

**5.** .

請求の範囲第1項または第2項に記載のエチレン系重合体からなる単層ま 15 たは多層のパイプ又はパイプ継ぎ手。

第1図

5



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2004/007124

A. CLASSIFIC Int.Cl <sup>7</sup>	ATION OF SUBJECT MATTER  C08F210/02, C08F4/645, B65D1/	00, F16L9/12					
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED							
Minimum docum Int.Cl <sup>7</sup>	entation searched (classification system followed by cla C08F210/00-210/18, C08F4/64-4	ssification symbols) /69, B65D1/00, F16L9/12	2				
	earched other than minimum documentation to the externation and the externation of the externation of description of the externation of the extern						
C DOCIMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	JP 2003-20306 A (Mitsui Chemi 24 January, 2003 (24.01.03), Full description (Family: none)	•	1-5				
A	A JP 2002-275332 A (Mitsui Chemicals, Inc.), 1-5 25 September, 2002 (25.09.02), Full description (Family: none)						
A	JP 2002-275342 A (Mitsui Cher 25 September, 2002 (25.09.02) Full description (Family: none)		1-5				
X Further do	cuments are listed in the continuation of Ray C	See patent family anney					
* Special cate  "A" document de to be of part  "E" earlier applie filing date  "L" document we cited to este special reaso  "O" document re  "P" document po	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other on (as specified) efferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ublished prior to the international filing date but later than date claimed	"T" later document published after the interdate and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the i "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consistently when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the document member of the same patent."	ation but cited to understand nvention  claimed invention cannot be dered to involve an inventive claimed invention cannot be step when the document is documents, such combination e art				
	d completion of the international search ast, 2004 (19.08.04)	Date of mailing of the international sear 07 September, 2004					
Japanes	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer					
Form PCT/ISA/21	0 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.					

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/00.7124

	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	
A	JP 2002-212217 A (Mitsui Chemicals, Inc.), 31 July, 2002 (31.07.02), Full description (Family: none)	1-5
A	WO 02/08306 Al (Mitsui Chemicals, Inc.), 31 January, 2002 (31.01.02), Full description & JP 2002-105132 A & EP 1241194 Al & BR 107037 A & US 2003/0120003 Al	1-5
!		
·		

_		<del></del>	<del>-                                    </del>	<del></del>					
A	A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))								
	Int. Cl <sup>7</sup> C08F210/02, C08F4/645, B65D1/00, F16L9/12								
p	B. 調査を行った分野								
		Tった分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))							
""	مار ۱۱ ت عصرت	WATERWAY ( TO )							
	Int. Cl <sup>7</sup> C08F210/00-210/18, C08F4/64-4/69, B65D1/00, F16L9/12								
最	 {小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの							
1	•								
[									
$\vdash$									
国	国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)						
<u> </u>									
_		ると認められる文献 T	<del></del>	胆油ナマ					
	用文献の カテゴリー*	   引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号					
广	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APT BUILD DAKE 7 W.C.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m v s papar v pa V					
	Α .	JP 2003-20306 A(三井化学株式会社)	2003_01_24_ 明細事令体	1-5					
'	A	JP 2003-20300 A(三升化字株式芸社)。   (ファミリーなし)	4000.01.44, PJ/叫首土冲						
			ł						
	Α	JP 2002-275332 A (三井化学株式会社	t) 2002, 09, 25. 明細書全休	1-5					
	••	(ファミリーなし)	_, _ , _ , , , , , , , , , , , , , , ,						
		,							
				<u> </u>					
[3	【 C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。					
F			D D D40 1+ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1						
		のカテゴリー 連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表 る	された文献であって					
	IA」特に関われる	ゲー・ハックザインはマノ、 WXHJIXMV市のから	出願と矛盾するものではなく、						
	「E」国際出	願日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの						
[		公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、						
		主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考; 「Y」特に関連のある文献であって、						
1	日右しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の12 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに								
	「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献よって進歩性がないと考えられるもの								
	「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献								
F	国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3								
=	19.08.2004 07. 9. 2004								
-				4 J 9 3 6 2					
国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員)									
	日本国特許庁(ISA/JP) 三谷 祥子 三谷 祥子 ———————————————————————————————————								
	乗収番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 6873								
1			1						

### 国際調査報告

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-275342 A (三井化学株式会社)2002.09.25, 明細書全体(ファミリーなし)	1-5
A	JP 2002-212217 A (三井化学株式会社)2002.07.31, 明細書全体 (ファミリーなし)	1-5
<b>A</b>	WO 02/08306 A1(三井化学株式会社)2002.01.31, 明細書全体 & JP02002-105132 A & EP 1241194 A1 & BR 107037 A & US 2003/0120003 A1	1-5
·		
		·
	=	